

10 813304

07-26-04



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

출원번호 : 10-2003-0020087
Application Number

CERTIFIED COPY OF
PRIOR DOCUMENT

출원년월일 : 2003년 03월 31일
Date of Application
MAR 31, 2003

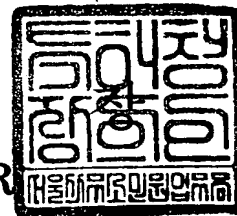
출원인 : 삼성전자주식회사
Applicant(s) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.



2004 년 03 월 03 일

특 허 청

COMMISSIONER



【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【권리구분】	특허
【수신처】	특허청장
【제출일자】	2003.03.31
【발명의 명칭】	박막 트랜지스터 표시판
【발명의 영문명칭】	Thin film transistor array panel
【출원인】	
【명칭】	삼성전자 주식회사
【출원인코드】	1-1998-104271-3
【대리인】	
【명칭】	유미특허법인
【대리인코드】	9-2001-100003-6
【지정된변리사】	김원근 , 박종하
【포괄위임등록번호】	2002-036528-9
【발명자】	
【성명의 국문표기】	이정호
【성명의 영문표기】	LEE, JEONG HO
【주민등록번호】	710228-1558310
【우편번호】	150-838
【주소】	서울특별시 영등포구 신길2동 186-294번지
【국적】	KR
【발명자】	
【성명의 국문표기】	함연식
【성명의 영문표기】	HAM, YEON SIK
【주민등록번호】	731109-1273517
【우편번호】	156-861
【주소】	서울특별시 동작구 흑석1동 200-99 11/2
【국적】	KR
【발명자】	
【성명의 국문표기】	이계현
【성명의 영문표기】	LEE, KYE HUN
【주민등록번호】	660427-1001613

【우편번호】 442-741

【주소】 경기도 수원시 팔달구 영통동 1052-2번지 쌍용아파트 242동
1104호

【국적】 KR

【취지】 특허법 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다. 대리인
유미특허법인 (인)

【수수료】

【기본출원료】	20 면	29,000 원
【가산출원료】	45 면	45,000 원
【우선권주장료】	0 건	0 원
【심사청구료】	0 항	0 원
【합계】		74,000 원

【첨부서류】 1. 요약서·명세서(도면)_1통

【요약서】**【요약】**

박막 트랜지스터 표시판은 절연 기판, 절연 기판 위에 형성되어 있는 게이트선 및 게이트 전극을 포함하는 게이트 배선, 게이트선 및 게이트 전극을 덮도록 형성되어 있는 게이트 절연막, 게이트 절연막 위에 형성되어 있는 반도체층, 반도체층의 소정 영역을 제외하고 반도체층 위에 형성되어 있는 저항성 접촉층, 저항성 접촉층과 일부분이 중첩하여 형성되며 게이트선과 교차하여 화소 영역을 정의하는 데이터선, 소스 전극 및 드레인 전극을 포함하는 데이터 배선, 데이터 배선 위에 형성되며 드레인 전극을 노출하는 접촉구를 가지는 보호막, 보호막 위의 데이터 배선과 대응하는 위치에 형성되어 있으며 유기 물질로 이루어져 있는 돌기, 화소 영역과 대응하는 보호막 위에 형성되어 있으며 접촉구를 통해 드레인 전극과 연결되어 있는 화소 전극을 포함한다.

【대표도】

도 4

【색인어】

액정표시장치, 도메인, 굵은 데이터선, 박막트랜지스터

【명세서】

【발명의 명칭】

박막 트랜지스터 표시판{Thin film transistor array panel}

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판의 배치도이고,

도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치의 공통 전극 표시판의 배치도이고,

도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배치도이고,

도 4는 도 3의 III-III'선에 대한 단면도이고,

도 5는 도 4의 V-V'선 및 V'-V''선에 대한 단면도이고,

도 6a 및 도 6b는 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판을 제조하는 중간 단계에서의 단면도이고,

도 7a 및 도 7b는 도 6a 및 도 6b의 다음 단계에서의 단면도이고,

도 8a 및 도 8b는 도 7a 및 도 7b의 다음 단계에서의 단면도이고,

도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배치도이고,

도 10은 도 9의 X-X'선에 대한 단면도이고,

도 11은 도 9의 XI-XI'선 및 XI'-XI''선에 대한 단면도이고,

도 12a 및 도 12b는 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판을 제조하는 중간 단계에서의 단면도이고,

도 13a 및 도 13b는 도 12a 및 도 12b의 다음 단계에서의 단면도이고,
 도 14a 및 도 14b는 도 13a 및 도 13b의 다음 단계에서의 단면도이고,
 도 15a 및 도 15b는 도 14a 및 도 14b의 다음 단계에서의 단면도이고,
 도 16은 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배치도이고,
 도 17는 도 16의 XVII-XVII'선에 대한 단면도이고,
 도 18은 도 16의 XVIII-XVIII'선 및 XVIII'-XVIII''선에 대한 단면도이고,
 도 19는 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배치도이고,
 도 20은 도 19의 XX-XX'선에 대한 단면도이고,
 도 21은 도 19의 XXI-XXI'선 및 XXI'-XXI''선에 대한 단면도이고,
 도 22와 도 23은 본 발명의 제5 실시예에 따른 액정 표시 장치의 단면도이고,
 도 24와 도 25은 본 발명의 제6 실시예에 따른 액정 표시 장치의 단면도이고,
 도 26와 도 27는 본 발명의 제7 실시예에 따른 액정 표시 장치의 단면도이고,
 도 28과 도 29은 본 발명의 제8 실시예에 따른 액정 표시 장치의 단면도이고,
 도 30은 본 발명의 제9 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배치도이고,
 도 31은 본 발명의 제10 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배치도이다.

※도면의 주요 부분에 대한 부호 설명※

110, 210 : 절연 기판	140 : 게이트 절연막
121, 123, 125 : 게이트 배선	171, 173, 175, 179 : 데이터 배선
131, 133 : 유지 전극 배선	180 : 보호막

190 : 화소 전극

220 : 블랙 매트릭스

230R, 230G, 230B : 색필터

270 : 공통 전극

280 : 돌기

【발명의 상세한 설명】**【발명의 목적】****【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】**

<35> 본 발명은 박막 트랜지스터 표시판에 관한 것이다.

<36> 액정 표시 장치는 일반적으로 공통 전극과 색 필터(color filter) 등이 형성되어 있는 색필터 표시판과 박막 트랜지스터와 화소 전극 등이 형성되어 있는 박막 트랜지스터 표시판에 액정 물질을 주입해 놓고 화소 전극과 공통 전극에 서로 다른 전위를 인가함으로써 전계를 형성하여 액정 분자들의 배열을 변경시키고, 이를 통해 빛의 투과율을 조절함으로써 화상을 표현하는 장치이다.

<37> 그런데 액정 표시 장치는 시야각이 좁은 것이 중요한 단점이다. 이러한 단점을 극복하고자 시야각을 넓히기 위한 다양한 방안이 개발되고 있는데, 그 중에서도 액정 분자를 상하 표시판에 대하여 수직으로 배향하고 화소 전극과 그 대향 전극인 공통 전극에 일정한 절개 패턴을 형성하거나 돌기를 형성하는 방법이 연구되고 있다.

<38> 그런데 돌기나 절개 패턴을 형성하는 방법에서는 돌기나 절개 패턴 부분으로 인하여 개구율이 떨어진다. 이를 보완하기 위하여 화소 전극을 최대한 넓게 형성하는 초고개구율 구조를 고안하였으나, 이러한 초고개구율 구조는 인접한 화소 전극 사이의 거리가 매우 가까워서 화소 전극 사이에 형성되는 측방향 전기장(lateral field)이 강하게 형성된다. 따라서 화소 전극

가장자리에 위치하는 액정들이 이 측방향 전기장에 영향을 받아 배향이 흐트러지고, 이로 인하여 텍스처나 빛샘이 발생하게 된다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

<39> 상기한 문제점을 해결하기 위한 본 발명은 빠른 응답 속도 및 텍스처를 최소화할 수 있는 박막 트랜지스터 표시판을 제공하기 위한 것이다.

【발명의 구성 및 작용】

<40> 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 박막 트랜지스터 표시판은 절연 기판, 절연 기판 위에 형성되어 있는 게이트선 및 게이트 전극을 포함하는 게이트 배선, 게이트선 및 게이트 전극을 덮도록 형성되어 있는 게이트 절연막, 게이트 절연막 위에 형성되어 있는 반도체층, 반도체층의 소정 영역을 제외하고 반도체층 위에 형성되어 있는 저항성 접촉층, 저항성 접촉층과 일부분이 중첩하여 형성되며 게이트선과 교차하여 화소 영역을 정의하는 데이터선, 소스 전극 및 드레인 전극을 포함하는 데이터 배선, 데이터 배선 위에 형성되며 드레인 전극을 노출하는 접촉구를 가지는 보호막, 보호막 위의 데이터 배선과 대응하는 위치에 형성되어 있으며 유기 물질로 이루어져 있는 돌기, 화소 영역과 대응하는 보호막 위에 형성되어 있으며 접촉구를 통해 드레인 전극과 연결되어 있는 화소 전극을 포함한다.

<41> 여기서 게이트선과 동일한 층에 형성되며 게이트선과 평행한 유지 전극선, 유지 전극선의 일부분이 확대 형성되어 드레인 전극과 중첩되어 있는 유지 전극을 더 포함할 수 있다.

<42> 또한, 돌기와 동일한 층에 형성되며 돌기보다 높게 형성되어 있는 컬럼 스페이서를 더 포함할 수 있다. 이때 화소 전극은 절개부를 가지며 유지 전극선은 절개부와 대응하고, 돌기는 절개부에 형성되어 있는 것이 바람직하다.

- <43> 그리고 데이터선은 굵은 부분과 직선 부분을 가지며 직선 부분은 게이트선과 교차하고, 굵은 부분은 화소 영역 내에 위치하는 것이 바람직하다.
- <44> 그리고 데이터선, 드레인 전극 및 소스 전극은 저항성 접촉층과 동일한 평면 패턴으로 형성되어 있고, 저항성 접촉층은 반도체층의 소정 영역을 제외하고 동일한 평면 패턴으로 형성되어 있는 것이 바람직하다.
- <45> 그리고 돌기는 데이터선의 폭보다 넓게 형성되어 있는 것이 바람직하다.
- <46> 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 다른 박막 트랜지스터 표시판은 절연 기판, 절연 기판 위에 형성되어 있는 게이트선 및 게이트 전극을 포함하는 게이트 배선, 게이트선 및 게이트 전극을 덮도록 형성되어 있는 게이트 절연막, 게이트 절연막 위에 형성되어 있는 반도체층, 반도체층의 소정 영역을 제외하고 반도체층 위에 형성되어 있는 저항성 접촉층, 저항성 접촉층과 일부분이 중첩하여 형성되며 게이트선과 교차하여 화소 영역을 정의하는 데이터선, 소스 전극 및 드레인 전극을 포함하는 데이터 배선, 데이터선, 소스 전극 및 드레인 전극 위에 형성되어 있는 제1 보호막, 제1 보호막 위에 형성되어 있는 적, 녹, 청색 색필터, 색필터 위에 형성되어 있는 제2 보호막, 제2 보호막 위에 형성되어 있는 돌기, 드레인 전극을 노출하는 접촉구를 통해 드레인 전극과 연결되어 있는 화소 전극을 포함한다.
- <47> 그리고 게이트선과 동일한 층에 형성되며 게이트선과 평행한 유지 전극선, 유지 전극선의 일부분이 확대 형성되어 드레인 전극과 중첩되어 있는 유지 전극을 더 포함하는 것이 바람직하다.
- <48> 또한, 돌기와 동일한 층에 형성되며 돌기보다 높게 형성되어 있는 컬럼 스페이서를 더 포함하는 것이 바람직하다.

- <49> 또한, 화소 전극은 절개부를 가지며 전극선은 절개부와 대응하고, 돌기는 절개부에 형성되어 있는 것이 바람직하다.
- <50> 그리고 데이터선은 굽은 부분과 직선 부분을 가지며 직선 부분은 게이트선과 교차하고, 굽은 부분은 화소 영역 내에 위치하는 것이 바람직하다.
- <51> 그리고 데이터선, 드레인 전극 및 소스 전극은 저항성 접촉층과 동일한 평면 패턴으로 형성되어 있고, 저항성 접촉층은 반도체층의 소정 영역을 제외하고 동일한 평면 패턴으로 형성되어 있는 것이 바람직하다.
- <52> 또한, 돌기는 데이터선의 폭보다 넓게 형성되어 있는 것이 바람직하다.
- <53> 이하 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.
- <54> 도면에서 여러 층 및 영역을 명확하게 표현하기 위하여 두께를 확대하여 나타내었다. 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다. 층, 막, 영역, 판 등의 부분이 다른 부분 "위에" 있다고 할 때, 이는 다른 부분 "바로 위에" 있는 경우뿐 아니라 그 중간에 또 다른 부분이 있는 경우도 포함한다. 반대로 어떤 부분이 다른 부분 "바로 위에" 있다고 할 때에는 중간에 다른 부분이 없는 것을 뜻한다.
- <55> 그러면 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치에 대하여 설명한다.

- <56> 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판의 배치도이고, 도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치의 색필터 표시판의 배치도이고, 도 3 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배치도이고, 도 4는 도 3의 IV-IV'선에 대한 단면도이고, 도 5는 도 3의 V-V'선 및 V'-V''선에 대한 단면도이다.
- <57> 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치는 박막 트랜지스터 표시판과 이와 마주보고 있는 색필터 표시판 및 이들 두 표시판 사이에 주입되어 있고 그에 포함되어 있는 액정 분자의 장축이 이들 표시판에 대하여 수직으로 배향되어 있는 액정층(3)으로 이루어진다.
- <58> 먼저, 도 1, 도 4 및 도 5를 참고로 하여 박막 트랜지스터 표시판에 대하여 좀 더 상세히 설명한다.
- <59> 절연 기판(110) 위에 가로 방향으로 게이트선(121)이 형성되어 있고, 게이트선(121)에 돌기의 형태로 게이트 전극(123)이 연결되어 있다. 게이트선(121)의 한쪽 끝부분(125)은 외부 회로와의 연결을 위하여 폭이 확장되어 있다.
- <60> 또 절연 기판(110) 위에는 유지 전극선(131)과 유지 전극(133)이 형성되어 있다. 유지 전극선(131)은 가로 방향으로 뻗어 있고 유지 전극(133)은 정사각형 또는 직사각형을 유지 전극선(131)에 대하여 45도 기울여 놓은 형태로 유지 전극선(131)에 연결되어 있다.
- <61> 게이트 배선(121, 123, 125) 및 유지 전극 배선(131, 133)은 물리 화학적 특성이 우수한 Cr 또는 Mo 합금 등으로 이루어지는 제1층(211, 231, 251, 311, 331)과, 저항이 작은 Al 또는 Ag 합금 등으로 이루어지는 제2층(212, 232, 252, 312, 332)의 이중층으로 형성되어 있다. 이들 게이트 배선(121, 123, 125) 및 유지 전극 배선(131, 133)은 필요에 따라서는 단일층으로 형성하거나 또는 3중층 이상으로 형성할 수도 있다.

- <62> 게이트 배선(121, 123, 125) 및 유지 전극 배선(131, 133)의 위에는 게이트 절연막(140)이 형성되어 있다.
- <63> 게이트 절연막(140) 위에는 비정질 규소 등의 반도체로 이루어진 반도체층(151, 154)이 형성되어 있다. 반도체층(151, 154)은 박막 트랜지스터의 채널을 형성하는 채널부 반도체층(154)과 데이터선(171) 아래에 위치하는 데이터선부 반도체층(151)을 포함한다.
- <64> 반도체층(151, 154)의 위에는 실리사이드 또는 n형 불순물이 고농도로 도핑되어 있는 n+ 수소화 비정질 규소 따위의 물질로 만들어진 저항성 접촉층(161, 163, 165)이 형성되어 있다. 저항성 접촉층(161, 163, 165)도 데이터선 아래에 위치하는 데이터선부 접촉층(161)과 소스 전극(173) 및 드레인 전극(175) 아래에 각각 위치하는 소스부 접촉층(163)과 드레인부 접촉층(165)으로 이루어져 있다.
- <65> 저항성 접촉층(161, 163, 165) 및 게이트 절연막(140) 위에는 데이터 배선(171, 173, 175, 179)이 형성되어 있다. 데이터 배선(171, 173, 175, 179)은 길게 뻗어 있으며 게이트선(121)과 교차하여 화소를 정의하는 데이터선(171), 데이터선(171)의 분지이며 저항성 접촉층(163)의 상부까지 연장되어 있는 소스 전극(173), 소스 전극(173)과 분리되어 있으며 게이트 전극(123)에 대하여 소스 전극(173)의 반대쪽 저항성 접촉층(165) 상부에 형성되어 있는 드레인 전극(175)으로 이루어져 있다. 데이터선(171)의 한쪽 끝부분(179)은 외부 회로와 연결하기 위하여 폭이 확장되어 있다.
- <66> 여기서, 데이터선(171)은 화소의 길이를 주기로 하여 반복적으로 굽은 부분과 세로로 뻗은 부분이 나타나도록 형성되어 있다. 이 때, 데이터선(171)의 굽은 부분은 두 개의 직선 부분으로 이루어지며, 이들 두 개의 직선 부분 중 하나는 게이트선(121)에 대하여 45도를 이루고, 다른 한 부분은 게이트선(121)에 대하여 -45도를 이룬다. 데이터선(171)의 세로로 뻗은 부

분에는 소스 전극(173)이 연결되어 있고, 이 부분이 게이트선(121) 및 유지 전극선(131)과 교차한다.

<67> 따라서, 게이트선(121)과 데이터선(171)이 교차하여 이루는 화소 영역은 꺾인 띠 모양으로 형성된다.

<68> 또, 드레인 전극(175)은 화소 전극(190)과 연결되는 부분이 직사각형 모양으로 넓게 확장되어서 유지 전극(133)과 중첩하고 있다. 이와 같이, 드레인 전극(175)은 유지 전극(133)과 게이트 절연막(140)만을 사이에 두고 중첩함으로써 유지 용량을 형성한다.

<69> 데이터 배선(171, 173, 175, 179) 위에는 유기 절연막으로 이루어진 보호막(180)이 형성되어 있다. 여기서 보호막(180)은 감광성 유기 물질을 노광 및 현상하여 형성한다. 필요에 따라서는 보호막(180)을 감광성이 없는 유기 물질을 도포하고 사진 식각 공정을 통하여 형성할 수도 있으나 감광성 유기 물질로 보호막(180)을 형성하는 것에 비하여 형성 공정이 복잡해진다.

<70> 보호막(180)에는 드레인 전극을 드러내는 접촉구(181b)와 데이터선의 폭이 확장되어 있는 끝부분(179)을 드러내는 접촉구(183b)가 형성되어 있다. 또, 게이트선의 폭이 확장되어 있는 끝부분(179)을 드러내는 접촉구(182b)는 보호막(180)과 함께 게이트 절연막(140)을 관통하여 형성되어 있다.

<71> 이때, 이들 접촉구(181b, 182b, 183b)의 측벽(181a, 182a, 183a)은 기판 면에 대하여 30도에서 85도 사이의 완만한 경사를 가지거나, 계단형 프로파일(profile)을 가진다.

<72> 또, 이들 접촉구(181b, 182b, 183b)는 각을 가지거나 원형의 다양한 모양으로 형성될 수 있으며, 면적은 $2\text{mm} \times 60\mu\text{m}$ 를 넘지 않으며, $0.5\text{mm} \times 15\mu\text{m}$ 이상인 것이 바람직하다.

- <73> 그리고 데이터 배선(171, 173, 175)과 대응하는 보호막(180) 위에는 돌기(280)가 형성되어 있다. 돌기(280)는 본 발명에 따른 박막 트랜지스터 표시판을 이용하여 액정 표시 장치를 형성할 때 주입되는 액정이 선경사를 가지도록 하여 구동시 액정의 응답 속도를 향상시킨다. 또한, 화소 전극(190)이 절개부(도시하지 않음)를 가지도록 형성되고 유지 전극 배선(131, 133)이 절개부와 대응하도록 형성될 경우 절개부에 돌기(280)가 더 형성될 수 있다.
- <74> 이때 돌기(280)를 배선을 덮도록 형성하면 데이터 배선(171, 173, 175)에 의한 기생 용량을 감소시킬 수 있어 측면 필드(lateral field)를 감소시킬 수 있으므로 텍스처를 제거할 수 있다.
- <75> 또한, 보호막(180) 위에는 접촉구(181b)를 통하여 드레인 전극(175)과 연결되어 있으며 화소 영역의 모양을 따라 꺾인 띠 모양으로 화소 전극(190)이 형성되어 있다. 이 때, 화소 전극(190)은 가장자리가 데이터선과 중첩할 정도로 넓게 형성되어 있어서 최대한의 개구율을 확보하고 있다.
- <76> 또 보호막(180) 위에는 접촉구(182b, 183b)를 통하여 게이트선의 끝부분(125)과 데이터선의 끝부분(179)과 각각 연결되어 있는 접촉 보조 부재(95, 97)가 형성되어 있다. 여기서, 화소 전극(190) 및 접촉 보조 부재(95, 97)는 ITO(indium tin oxide) 또는 IZO(indium zinc oxide)로 이루어져 있다.
- <77> 이제, 도 2, 도 4 및 도 5를 참고로 하여 색필터 표시판에 대하여 설명한다.
- <78> 유리 등의 투명한 절연 물질로 이루어진 절연 기판(210)의 일면에 빛샘을 방지하기 위한 블랙 매트릭스(220)와 적, 녹, 청색의 색필터(230)가 형성되어 있고, 색필터(230) 위에는 유기 물질로 이루어진 오버코트막(250)이 형성되어 있다. 오버코트막(250)의 위에는 ITO 또는

IZO 등의 투명한 도전 물질로 이루어져 있으며 절개부(271)를 가지는 공통 전극(270)이 형성되어 있다.

<79> 여기서 블랙 매트릭스(220)는 데이터선(171)의 굽은 부분에 대응하는 선형 부분과 데이터선(171)의 세로로 뻗은 부분 및 박막 트랜지스터 부분에 대응하는 삼각형 부분을 포함한다.

<80> 색필터(230)는 블랙 매트릭스(220)에 의하여 구획되는 화소 열을 따라 세로로 길게 형성되어 있고 화소의 모양을 따라 주기적으로 구부러져 있다.

<81> 공통 전극(270)의 절개부(271) 역시 구부러져 있어서 굽은 화소 영역을 좌우로 양분하는 모양으로 형성되어 있다. 또, 절개부(271)의 양단은 한번 더 구부러져서 한쪽 끝은 게이트선(121)과 나란하고 다른 한쪽 끝은 데이터선(171)의 세로로 뻗은 부분과 나란하다.

<82> 이상과 같은 구조의 박막 트랜지스터 표시판과 공통 전극 표시판을 결합하고 그 사이에 액정을 주입하여 액정층(3)을 형성하면 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치의 기본 패널이 이루어진다.

<83> 액정층(3)에 포함되어 있는 액정 분자는 화소 전극(190)과 공통 전극(270) 사이에 전계가 인가되지 않은 상태에서 그 방향자가 하부 기판(110)과 상부 기판(210)에 대하여 수직을 이루도록 배향되어 있고, 음의 유전율 이방성을 가진다. 박막 트랜지스터 기판(110)과 색필터 표시판(210)은 화소 전극(190)이 색필터(230)와 대응하여 정확하게 중첩되도록 정렬된다. 이렇게 하면, 화소 영역은 절개부(271)에 의하여 복수의 도메인으로 분할된다. 이 때, 화소 영역은 절개부(271)에 의하여 좌우로 양분되나, 화소의 꺾인 부분을 중심으로 하여 상하에서 액정의 배향 방향이 서로 달라서 4개의 도메인으로 분할된다.

- <84> 액정 표시 장치는 이러한 기본 패널 양측에 편광판(도시하지 않음), 백라이트(도시하지 않음), 보상판(도시하지 않음) 등의 요소들을 배치하여 이루어진다. 이 때 편광판은 기본 패널 양측에 각각 하나씩 배치되며 그 투과축은 게이트선(121)에 대하여 나란하거나 수직을 이루도록 배치한다.
- <85> 이상과 같은 구조로 액정 표시 장치를 형성하면 액정에 전계를 인가되었을 때 각 도메인 내의 액정이 도메인의 장변에 대하여 수직을 이루는 방향으로 기울어지게 된다. 그런데 이 방향은 데이터선(171)에 대하여 수직을 이루는 방향이므로 데이터선(171)을 사이에 두고 인접하는 두 화소 전극(190) 사이에서 형성되는 측방향 전계에 의하여 액정이 기울어지는 방향과 일치하는 것으로서 측방향 전계가 각 도메인의 액정 배향을 도와주게 된다.
- <86> 액정 표시 장치는 데이터선(171) 양측에 위치하는 화소 전극에 극성이 반대인 전압을 인가하는 점반전 구동, 열반전 구동, 2점 반전 구동 등의 반전 구동 방법을 일반적으로 사용하므로 측방향 전계는 거의 항상 발생하고 그 방향은 도메인의 액정 배향을 돕는 방향이 된다.
- <87> 또한, 편광판의 투과축을 게이트선(121)에 대하여 수직 또는 나란한 방향으로 배치하므로 편광판을 저렴하게 제조할 수 있으면서도 모든 도메인에서 액정의 배향 방향이 편광판의 투과축과 45도를 이루게 되어 빛샘이 최소화된다.
- <88> 다만, 데이터선(171)이 구부러지므로 배선의 길이가 증가하게 되는데, 데이터선(171)에서 굽은 부분이 50%를 차지할 경우 배선의 길이는 약 20% 증가하게 된다. 데이터선(171)의 길이가 증가할 경우 배선의 저항과 부하가 증가하게 되어 신호 왜곡이 증가하는 문제점이 있다. 그러나 초고개구율 구조에서는 데이터선(171)의 폭을 충분히 넓게 형성할 수 있고, 두꺼운 유기물 보호막(180)을 사용하므로 배선의 부하도 충분히 작아서 데이터선(171)의 길이 증가에 따른 신호 왜곡 문제는 무시할 수 있다.

- <89> 이러한 구조의 액정 표시 장치에 있어서 박막 트랜지스터 표시판을 제조하는 방법에 대하여 설명한다.
- <90> 도 6a 및 도 6b는 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판을 제조하는 중간 단계에서의 단면도이고, 도 7a 및 도 7b는 도 6a 및 도 6b의 다음 단계에서의 단면도이다.
- <91> 먼저, 도 6a 및 도 6b에 도시한 바와 같이, Cr 또는 Mo 합금 등으로 이루어지는 제1 금속층(211, 231, 251, 311, 331)과 저항이 작은 Al 또는 Ag 합금 등으로 이루어지는 제2 금속층(212, 232, 252, 312, 332)을 스퍼터링 따위의 방법으로 연속 적층하고 마스크를 이용한 첫 번째 사진 식각 공정으로 건식 또는 습식 식각하여, 기판(110) 위에 게이트선(121, 125) 및 게이트 전극(123)을 포함하는 게이트 배선과 유지 전극선(131) 및 유지 전극(133)을 포함하는 유지 배선을 형성한다(제1 마스크).
- <92> 다음, 게이트 절연막(140), 수소화 비정질 규소층 및 인(P) 따위의 n형 불순물이 고농도로 도핑되어 있는 비정질 규소층을 화학 기상 증착법을 이용하여 각각 1,500 Å 내지 5,000 Å, 500 Å 내지 2,000 Å, 300 Å 내지 600 Å의 두께로 연속 증착하고, 마스크를 이용한 사진 식각 공정으로 도핑된 비정질 규소층과 비정질 규소층을 차례로 패터닝하여 채널부가 연결되어 있는 저항성 접촉층과 비정질 규소층(151, 154)을 형성한다(제2 마스크).
- <93> 이어, Cr 또는 Mo 합금 등으로 이루어지는 제1 금속층(711, 731, 751, 791)과, 저항이 작은 Al 또는 Ag 합금 등으로 이루어지는 제2 금속층(712, 732, 752, 792) 따위의 도전체층을 스퍼터링 등의 방법으로 1,500 Å 내지 3,000 Å의 두께로 증착한 다음 마스크를 이용한 사진 식각 공정으로 패터닝하여 데이터선(171, 179), 소스 전극(173), 드레인 전극(175)을 포함하는 데이터 배선을 형성한다(제3 마스크).

- <94> 이어, 소스 전극(173)과 드레인 전극(175)으로 가려지지 않은 저항성 접촉층을 식각하여 소스 전극(173)과 드레인 전극(175) 사이의 반도체층(154)을 드러내고 양쪽으로 분리된 저항성 접촉층(163, 165)을 형성한다.
- <95> 이어, 도 7a 및 도 7b에 도시한 바와 같이, 감광성 유기 절연 물질을 도포하여 보호막(180)을 형성하고, 슬릿 부분(501)을 가지는 광마스크(500)를 통하여 노광한다.
- <96> 이 때, 광마스크의 슬릿 부분(501)은 접촉구(181b, 182b, 183b)의 단차 문제를 완화시켜 주기 위하여 접촉구 측벽(181a, 182a, 183a)의 경사를 완만하게 하거나 계단형 프로파일을 가지도록 하기 위한 부분으로 접촉구의 측벽(181a, 182a, 183a)이 될 부분에 대응하도록 배치한다.
- <97> 이와 같이 슬릿 부분(501)을 가지는 광마스크를 통하여 보호막(180)을 노광하면 도 7a 및 도 7b에 도시한 바와 같이, 보호막(180)의 접촉구(181b, 182b, 183b)가 될 부분은 모두 감광되고 접촉구의 측벽(181a, 182a, 183a)이 될 부분은 부분적으로 감광된다. 감광되었다 함은 빛에 의하여 폴리머가 분해된 것을 의미한다.
- <98> 이어서, 보호막(180)을 현상하여 접촉구(181b, 182b, 183b)와 그 측벽(181a, 182a, 183a)을 형성한다(제4 마스크).
- <99> 도 8a 및 도 8b에 도시한 바와 같이, 보호막(180) 위에 유기 물질을 도포하여 돌기용 유기막을 형성한다. 이후 돌기용 유기막을 마스크를 이용한 사진 식각 공정으로 패터닝하여 돌기(280)를 형성한다. 돌기(280)는 데이터 배선(171, 173, 175)과 대응하는 부분에 형성한다(제5 마스크).

- <100> 다음, 도 4 및 도 5에 도시한 바와 같이, 접촉구(181b, 182b, 183b)를 통해 노출되어 있는 배선의 제2 금속층(252, 752, 792)을 식각하여 제거하고, ITO 또는 IZO를 400 Å 내지 500 Å 두께로 증착하고 사진 식각하여 화소 전극(190)과 접촉 보조 부재(95, 97)를 형성한다(제6 마스크).
- <101> 이러한 방법은 6매의 마스크를 이용하는 제조 방법이지만, 5매 마스크를 이용해서도 본 발명에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판을 제조할 수 있다. 이에 대하여 도 9 내지 도 14b를 참조하여 상세하게 설명한다.
- <102> 도 9는 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배치도이고,
- <103> 도 10은 도 9의 X-X'선에 대한 단면도이고, 도 11은 도 9의 XI-XI'선 및 XI''-XI'''선에 대한 단면도이다.
- <104> 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판은 5매 마스크 공정으로 제조한 것으로서 6매 마스크 공정으로 제조한 박막 트랜지스터 표시판에 비하여 다음과 같은 특징을 가진다.
- <105> 데이터선(171, 179), 소스 전극(173) 및 드레인 전극(175)을 포함하는 데이터 배선 아래 이와 실질적으로 동일한 패턴으로 접촉층(161, 163, 165, 169)이 형성되어 있고, 소스 전극(173)과 드레인 전극(175) 사이의 채널부가 연결되어 있는 것을 제외하고 비정질 규소층(151, 154, 159)도 데이터 배선과 실질적으로 동일한 패턴을 가진다.
- <106> 그러면 이러한 구조적 특징을 가지는 박막 트랜지스터 표시판의 제조 방법에 대하여 설명한다.

- <107> 도 12a 및 도 12b는 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판을 제조하는 중간 단계에서의 단면도이고, 도 13a 및 도 13b는 도 12a 및 도 12b의 다음 단계에서의 단면도이고, 도 14a 및 도 14b는 도 13a 및 도 13b의 다음 단계에서의 단면도이다.
- <108> 먼저, 도 12a 및 12b에 도시한 바와 같이, Cr 또는 Mo 합금 등으로 이루어지는 제1 금속층(211, 231, 251, 311, 331)과 저항이 작은 Al 또는 Ag 합금 등으로 이루어지는 제2 금속층(212, 232, 252, 312, 332)을 스퍼터링 따위의 방법으로 연속 적층하고 마스크를 이용한 첫 번째 사진 식각 공정으로 건식 또는 습식 식각하여, 기판(110) 위에 게이트선(121, 125) 및 게이트 전극(123)을 포함하는 게이트 배선과 유지 전극선(131) 및 유지 전극(133)을 포함하는 유지 배선을 형성한다 (제1 마스크).
- <109> 다음, 질화 규소로 이루어진 게이트 절연막(140), 비정질 규소층(150), n형 불순물이 고농도로 도핑된 비정질 규소로 이루어진 접촉층(160)을 화학 기상 증착법을 이용하여 각각 1,500 Å 내지 5,000 Å, 500 Å 내지 2,000 Å, 300 Å 내지 600 Å의 두께로 연속 증착하고, 이어 Cr 또는 Mo 합금 등으로 이루어지는 제1 금속층(701)과 저항이 작은 Al 또는 Ag 합금 등으로 이루어지는 제2 금속층(702)을 스퍼터링 따위의 방법으로 연속 적층하고, 그 위에 감광막(PR)을 1 μ m 내지 2 μ m의 두께로 도포한다.
- <110> 그 후, 마스크를 통하여 감광막(PR)을 노광하여, 도 11a 및 11b에 도시한 바와 같이, 두께 전체가 감광된 부분과 두께의 일부만 감광된 부분을 가지는 감광막 패턴(PR)을 형성한다.
- <111> 이어서 감광막(PR)을 현상하면 박막 트랜지스터의 채널부, 즉 소스 전극(173)과 드레인 전극(175) 사이에 위치한 부분은 데이터 배선이 형성될 부분(데이터 배선부)에 위치한 부분보다 두께가 작게 되고, 기타 부분의 감광막은 모두 제거된다. 이 때, 채널부에 남아 있는 감광

막의 두께와 데이터 배선부에 남아 있는 감광막의 두께의 비는 후술할 식각 공정에서의 공정 조건에 따라 다르게 하여야 하되, 전자의 두께를 후자의 두께의 1/2 이하로 하는 것이 바람직하며, 예를 들면, 4,000 Å 이하인 것이 좋다 (제2 마스크).

<112> 이와 같이, 위치에 따라 감광막의 두께를 달리하는 방법으로 여러 가지가 있을 수 있으며, 도 11a 및 도 11b에서와 같이 슬릿(slit)을 이용하거나 격자 형태의 패턴을 형성하거나 반투명막을 사용한다.

<113> 이때, 슬릿 사이에 위치한 패턴의 선 폭이나 패턴 사이의 간격, 즉 슬릿의 폭은 노광시 사용하는 노광기의 분해능보다 작은 것이 바람직하며, 반투명막을 이용하는 경우에는 마스크를 제작할 때 투과율을 조절하기 위하여 다른 투과율을 가지는 박막을 이용하거나 두께가 다른 박막을 이용할 수 있다.

<114> 이와 같은 마스크를 통하여 감광막에 빛을 조사하면 빛에 직접 노출되는 부분에서는 고분자들이 완전히 분해되며, 슬릿 패턴이나 반투명막이 형성되어 있는 부분에서는 빛의 조사량이 적으므로 고분자들은 완전 분해되지 않은 상태이며, 차광막으로 가려진 부분에서는 고분자가 거의 분해되지 않는다. 이어 감광막을 현상하면, 고분자 분자들이 분해되지 않은 부분만이 남고, 빛이 적게 조사된 중앙 부분에는 빛에 전혀 조사되지 않은 부분보다 얇은 두께의 감광막을 남길 수 있다. 이때, 노광 시간을 길게 하면 모든 분자들이 분해되므로 그렇게 되지 않도록 해야 한다.

<115> 이러한 얇은 두께의 감광막은 리플로우가 가능한 물질로 이루어진 감광막을 도포하고 빛이 완전히 투과할 수 있는 부분과 빛이 완전히 투과할 수 없는 부분으로 나뉘어진 통상적인 마스크를 사용하여 노광한 다음, 현상하고 리플로우시켜 감광막이 잔류하지 않는 부분으로 감광막의 일부를 흘러내리도록 함으로써 형성할 수도 있다.

- <116> 이어, 감광막 패턴(PR) 및 그 하부의 막들, 즉 제1 및 제2 금속층(701, 702), 접촉층(160) 및 반도체층(150)에 대한 식각을 진행한다. 이때, 데이터 배선부에는 데이터 배선 및 그 하부의 막들이 그대로 남아 있고, 채널부에는 반도체층만 남아 있어야 하며, 나머지 부분에는 위의 3개 층(150, 160, 701, 702)이 모두 제거되어 게이트 절연막(140)이 드러나야 한다.
- <117> 먼저, 노출되어 있는 제1 및 제2 금속층(701, 702)을 제거하여 그 하부의 중간층(160)을 노출시킨다. 이 과정에서는 건식 식각 또는 습식 식각 방법을 모두 사용할 수 있으며, 이때 제1 및 제2 금속층(701, 702)은 식각되고 감광막 패턴(PR)은 거의 식각되지 않는 조건 하에서 행하는 것이 좋다. 그러나, 건식 식각의 경우 금속층(701, 702)만을 식각하고 감광막 패턴(PR)은 식각되지 않는 조건을 찾기가 어려우므로 감광막 패턴(PR)도 함께 식각되는 조건 하에서 행할 수 있다. 이 경우에는 습식 식각의 경우보다 채널부 감광막의 두께를 두껍게 하여 이 과정에서 채널부 감광막이 제거되어 그 아래의 제2 금속층(702)이 드러나는 일이 생기지 않도록 한다.
- <118> 이렇게 하면, 채널부 및 데이터 배선부의 제1 및 제2 금속층(701, 702)만이 남고 기타 부분의 제1 및 제2 금속층(701, 702)은 모두 제거되어 그 하부의 접촉층(160)이 드러난다.
- <119> 이어, 기타 부분의 노출된 접촉층(160) 및 그 하부의 비정질 규소층(150)을 채널부 감광막과 함께 건식 식각 방법으로 동시에 제거한다. 이 때의 식각은 감광막 패턴(PR)과 접촉층(160) 및 반도체층(150)(반도체층과 접촉층은 식각 선택성이 거의 없음)이 동시에 식각되며 게이트 절연막(140)은 식각되지 않는 조건 하에서 행하여야 하며, 특히 감광막 패턴(PR)과 반도체층(150)에 대한 식각비가 거의 동일한 조건으로 식각하는 것이 바람직하다. 예를 들어, SF₆과 HCl의 혼합 기체나, SF₆과 O₂의 혼합 기체를 사용하면 거의 동일한 식각율로 두 막을 식각

할 수 있다. 감광막 패턴(PR)과 반도체층(150)에 대한 식각율이 동일한 경우 채널부 감광막의 두께는 반도체층(150)과 중간층(160)의 두께를 합한 것과 같거나 그보다 작아야 한다.

<120> 이렇게 하면, 채널부의 감광막이 제거되어 제2 금속층(702)이 드러나고, 기타 부분의 접촉층(160) 및 반도체층(150)이 제거되어 그 하부의 게이트 절연막(140)이 드러난다. 한편, 데이터 배선부의 감광막 역시 식각되므로 두께가 얇아진다. 또한, 이 단계에서 반도체층 패턴(151, 154, 159)이 완성된다.

<121> 이어 애싱(ashing)을 통하여 채널부(C)의 제2 금속층(702)의 표면에 남아 있는 감광막 찌꺼기를 제거한다.

<122> 다음, 도 13a 및 13b에 도시한 바와 같이 채널부의 제1 및 제2 금속층(701, 702) 및 그 아래의 접촉층(160)을 식각하여 제거한다. 이 때, 식각은 제1 및 제2 금속층(701, 702)과 접촉층(160) 모두에 대하여 건식 식각만으로 진행할 수도 있으며, 제1 및 제2 금속층(701, 702)에 대해서는 습식 식각으로, 접촉층(160)에 대해서는 건식 식각으로 행할 수도 있다. 전자의 경우 제1 및 제2 금속층(701, 702)과 접촉층(160)의 식각 선택비가 큰 조건 하에서 식각을 행하는 것이 바람직하다. 이는 식각 선택비가 크지 않을 경우 식각 종점을 찾기가 어려워 채널부에 남는 반도체 패턴(154)의 두께를 조절하기가 쉽지 않기 때문이다. 습식 식각과 건식 식각을 번갈아 하는 후자의 경우에는 습식 식각되는 제1 및 제2 금속층(701, 702)은 언더컷이 발생하나, 건식 식각되는 접촉층(160)은 언더컷이 거의 발생하지 않으므로 계단 모양으로 만들어진다. 접촉층(160a, 160b) 및 반도체 패턴(151a, 151b)을 식각할 때 사용하는 식각 기체의 예로는 CF₄와 HCl의 혼합 기체나 CF₄와 O₂의 혼합 기체를 들 수 있으며, CF₄와 O₂를 사용하면 균일한 두께로 채널부 반도체 패턴(154)을 남길 수 있다.

- <123> 이렇게 하면, 소스 전극(173)과 드레인 전극(175)이 분리되면서 데이터 배선(171, 173, 175, 179)과 그 하부의 접촉층 패턴(161, 163, 165, 169)이 완성된다.
- <124> 다음, 도 14a 및 도 14b에 도시한 바와 같이, 감광성 유기 절연 물질을 도포하여 보호막(180)을 형성하고, 슬릿 부분(501)을 가지는 광마스크(500)를 통하여 노광한다.
- <125> 이 때, 광마스크의 슬릿 부분(501)은 접촉구(181b, 182b, 183b)의 단차를 문제를 완화시켜 주기 위하여 접촉구 측벽(181a, 182a, 183a)의 경사를 완만하게 하거나 계단형 프로파일을 가지도록 하기 위한 부분으로 접촉구의 측벽(181a, 182a, 183a)이 될 부분에 대응하도록 배치한다.
- <126> 이와 같이 슬릿 부분(501)을 가지는 광마스크를 통하여 보호막(180)을 노광하면 도 14a 및 도 14b에 도시한 바와 같이, 보호막(180)의 접촉구(181b, 182b, 183b)가 될 부분은 모두 감광되고 접촉구의 측벽(181a, 182a, 183a)이 될 부분은 부분적으로 감광된다.
- <127> 이어서, 보호막(180)을 현상하여 접촉구(181b, 182b, 183b)와 그 측벽(181a, 182a, 183a)을 형성한다(제3 마스크).
- <128> 보호막(180)은 감광성이 없는 유기 물질로 형성할 수도 있으나, 이 경우에는 접촉구(181b, 182b, 183b) 형성을 위하여 사진 식각 공정을 사용하여야 한다.
- <129> 다음, 도 15a 및 도 15b에 도시한 바와 같이, 접촉구(181b, 182b, 183b)를 통해 노출되어 있는 배선의 제2 금속층(252, 752, 792)을 식각하여 제거하고, 유기 물질을 도포하여 돌기용 유기막을 형성한다. 돌기용 유기막을 마스크를 이용한 사진 식각 공정으로 패터닝하여 돌기(280)를 형성한다(제4 마스크). 돌기(280)는 유지 전극 배선(131, 133), 데이터 배선(171, 173, 175)와 대응하며 이들을 덮도록 형성한다.

- <130> 도 10 및 도 11에 도시한 바와 같이, 보호막(180) 위에 ITO 또는 IZO를 400 Å 내지 500 Å 두께로 증착하고 사진 식각하여 화소 전극(190)과 접촉 보조 부재(95, 97)를 형성한다(제5 마스크).
- <131> 이때, 화소 전극(190) 및 접촉 보조 부재(95, 97)를 IZO로 형성하는 경우에는 식각액으로 크롬 식각액을 사용할 수 있어서 이들을 형성하기 위한 사진 식각 과정에서 접촉구를 통해 드러난 데이터 배선이나 게이트 배선 금속이 부식되는 것을 방지할 수 있다. 이러한 크롬 식각액으로는 $(\text{HNO}_3/(\text{NH}_4)_2\text{Ce}(\text{NO}_3)_6/\text{H}_2\text{O})$ 등이 있다. 또한, 접촉부의 접촉 저항을 최소화하기 위해서는 IZO를 상온에서 200℃ 이하의 범위에서 적층하는 것이 바람직하며, IZO 박막을 형성하기 위해 사용하는 표적(target)은 In_2O_3 및 ZnO 를 포함하는 것이 바람직하며, ZnO 의 함유량은 15-20 at% 범위인 것이 바람직하다.
- <132> 한편, ITO나 IZO를 적층하기 전의 예열(pre-heating) 공정에서 사용하는 기체로는 질소를 사용하는 것이 바람직하며, 이는 접촉구(181b, 182b, 183b)를 통해 드러난 금속막의 상부에 금속 산화막이 형성되는 것을 방지하기 위함이다.
- <133> 위의 제1 및 제2 실시예에서는 색필터가 공통 전극 표시판에 형성되어 있으나 이와 달리 박막 트랜지스터 기판에 형성될 수도 있다. 이러한 구조에 대하여 제3 내지 제8 실시예로서 설명한다.
- <134> 도 16은 본 발명의 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배치도이고, 도 17은 도 16의 XVII-XVII'선에 대한 단면도이고, 도 18은 도 16의 XVIII-XVIII'선 및 XVIII'-XVIII''선에 대한 단면도이다.
- <135> 먼저, 박막 트랜지스터 표시판에 대하여 상세히 설명한다.

- <136> 절연 기판(110) 위에 가로 방향으로 게이트선(121)이 형성되어 있고, 게이트선(121)에 돌기의 형태로 게이트 전극(123)이 연결되어 있다. 게이트선(121)의 한쪽 끝부분(125)은 외부 회로와의 연결을 위하여 폭이 확장되어 있다.
- <137> 또 절연 기판(110) 위에는 유지 전극선(131)과 유지 전극(133)이 형성되어 있다. 유지 전극선(131)은 가로 방향으로 뻗어 있고 유지 전극(133)은 정사각형 또는 직사각형을 유지 전극선(131)에 대하여 45도 기울여 놓은 형태로 유지 전극선(131)에 연결되어 있다.
- <138> 게이트 배선(121, 123, 125) 및 유지 전극 배선(131, 133)은 물리 화학적 특성이 우수한 Cr 또는 Mo 합금 등으로 이루어지는 제1층(211, 231, 251, 311, 331)과, 저항이 작은 Al 또는 Ag 합금 등으로 이루어지는 제2층(212, 232, 252, 312, 332)의 이중층으로 형성되어 있다. 이들 게이트 배선(121, 123, 125) 및 유지 전극 배선(131, 133)은 필요에 따라서는 단일층으로 형성하거나 또는 3중층 이상으로 형성할 수도 있다.
- <139> 게이트 배선(121, 123, 125) 및 유지 전극 배선(131, 133)의 위에는 게이트 절연막(140)이 형성되어 있다.
- <140> 게이트 절연막(140) 위에는 비정질 규소 등의 반도체로 이루어진 반도체층(151, 154)이 형성되어 있다. 반도체층(151, 154)은 박막 트랜지스터의 채널을 형성하는 채널부 반도체층(154)과 데이터선(171) 아래에 위치하는 데이터선부 반도체층(151)을 포함한다.
- <141> 반도체층(151, 154)의 위에는 실리사이드 또는 n형 불순물이 고농도로 도핑되어 있는 n+ 수소화 비정질 규소 따위의 물질로 만들어진 저항성 접촉층(161, 163, 165)이 형성되어 있다. 저항성 접촉층(161, 163, 165)도 데이터선 아래에 위치하는 데이터선부 접촉층(161)과 소

스 전극(173) 및 드레인 전극(175) 아래에 각각 위치하는 소스부 접촉층(163)과 드레인부 접촉층(165)으로 이루어져 있다.

<142> 저항성 접촉층(161, 163, 165) 및 게이트 절연막(140) 위에는 데이터 배선(171, 173, 175, 179)이 형성되어 있다. 데이터 배선(171, 173, 175, 179)은 길게 뻗어 있으며 게이트선(121)과 교차하여 화소를 정의하는 데이터선(171), 데이터선(171)의 분지이며 저항성 접촉층(163)의 상부까지 연장되어 있는 소스 전극(173), 소스 전극(173)과 분리되어 있으며 게이트 전극(123)에 대하여 소스 전극(173)의 반대쪽 저항성 접촉층(165) 상부에 형성되어 있는 드레인 전극(175)으로 이루어져 있다. 데이터선(171)의 한쪽 끝부분(179)은 외부 회로와 연결하기 위하여 폭이 확장되어 있다.

<143> 여기서, 데이터선(171)은 화소의 길이를 주기로 하여 반복적으로 굽은 부분과 세로로 뻗은 부분이 나타나도록 형성되어 있다. 이 때, 데이터선(171)의 굽은 부분은 두 개의 직선 부분으로 이루어지며, 이들 두 개의 직선 부분 중 하나는 게이트선(121)에 대하여 실질적으로 45도를 이루고, 다른 한 부분은 게이트선(121)에 대하여 실질적으로 -45도를 이룬다. 데이터선(171)의 세로로 뻗은 부분에는 소스 전극(173)이 연결되어 있고, 이 부분이 게이트선(121) 및 유지 전극선(131)과 교차한다.

<144> 따라서, 게이트선(121)과 데이터선(171)이 교차하여 이루는 화소 영역은 꺾인 띠 모양으로 형성된다.

<145> 또, 드레인 전극(175)은 화소 전극(190)과 연결되는 부분이 직사각형 모양으로 넓게 확장되어서 유지 전극(133)과 중첩하고 있다. 이와 같이, 드레인 전극(175)은 유지 전극(133)과 게이트 절연막(140)만을 사이에 두고 중첩함으로써 유지 용량을 형성한다.

- <146> 데이터 배선(171, 173, 175, 179) 위에는 질화규소 등의 무기 절연 물질로 이루어진 제1 보호막(801)이 형성되어 있다.
- <147> 제1 보호막(801) 위에는 적색, 녹색 및 청색의 색필터(230R, 230G, 230B)가 형성되어 있다. 색필터(230R, 230G, 230B)는 각각 데이터선(171)에 의하여 구획되는 화소 열을 따라 세로로 길게 형성되어 있고 화소의 모양을 따라 주기적으로 구부러져 있다. 또한, 색필터(230R, 230G, 230B)는 이웃하는 색필터(230R, 230G, 230B)가 데이터선(171) 위에서 서로 부분적으로 중첩되어 있어서 데이터선(171) 위에서 언덕을 이루고 있다.
- <148> 색필터(230R, 230G, 230B) 위에는 감광성 유기 물질로 이루어진 제2 보호막(802)이 형성되어 있다. 제2 보호막(802)도 색필터(230R, 230G, 230B)의 중첩에 의하여 형성된 언덕을 타고 넘으면서 언덕을 이루고 있다.
- <149> 드레인 전극(175) 위와 데이터선의 폭이 확장되어 있는 한쪽 끝부분(179)의 위에는 제1 및 제2 보호막(801, 802)을 관통하여 드레인 전극(175)과 데이터선의 끝부분(179)을 각각 드러내는 접촉구(181b, 183b)가 형성되어 있다. 또, 게이트선의 폭이 확장되어 있는 한쪽 끝부분(179)의 위에는 제1 및 제2 보호막(801, 802)과 함께 게이트 절연막(140)을 관통하여 게이트선의 끝부분(179)을 노출하는 접촉구(182b)가 형성되어 있다.
- <150> 이때, 이들 접촉구(181b, 182b, 183b)의 측벽(181a, 182a, 183a)은 기판 면에 대하여 30도에서 85도 사이의 완만한 경사를 가지거나, 계단형 프로파일(profile)을 가진다.
- <151> 또, 이들 접촉구(181b, 182b, 183b)는 각을 가지거나 원형의 다양한 모양으로 형성될 수 있으며, 면적은 $2\text{mm} \times 60\mu\text{m}$ 를 넘지 않으며, $0.5\text{mm} \times 15\mu\text{m}$ 이상인 것이 바람직하다.

- <152> 한편, 색필터(230R, 230G, 230B)는 드레인 전극(175) 위에서는 제거되어 있어서 드레인 전극(175)을 노출하는 접촉구(181b)는 제1 및 제2 보호막(801, 802)만을 관통하고 있다. 또한, 화소를 구성하지 않는 게이트선의 끝부분(125)과 데이터선의 끝부분(179)에도 색필터(230R, 230G, 230B)를 형성하지 않는다.
- <153> 한편, 제2 보호막(802)은 유기 물질로 형성하여 데이터 배선과 중첩하는 부분의 기생 용량을 줄여준다.
- <154> 그리고 데이터 배선(171, 173, 175)과 대응하는 보호막(180) 위에는 돌기(280)가 형성되어 있다. 돌기(280)는 본 발명에 따른 박막 트랜지스터 표시판을 이용하여 액정 표시 장치를 형성할 때 주입되는 액정이 선경사를 가지도록 하여 구동시 액정의 응답 속도를 향상시킨다. 또한, 화소 전극(190)이 절개부(도시하지 않음)를 가지도록 형성되고 유지 전극 배선(131, 133)이 절개부와 대응하도록 형성될 경우 절개부에 돌기(280)가 더 형성될 수 있다.
- <155> 이때 돌기(280)를 배선을 덮도록 형성하면 데이터 배선(171, 173, 175)에 의한 기생 용량을 감소시킬 수 있어 측면 필드(lateral field)를 감소시킬 수 있으므로 텍스처를 제거할 수 있다.
- <156> 접촉구(181b)를 통하여 드레인 전극(175)과 연결되어 있으며 화소 영역의 모양을 따라 꺾인 띠 모양으로 화소 전극(190)이 형성되어 있다.
- <157> 또 보호막(180) 위에는 접촉구(182b, 183b)를 통하여 게이트선의 끝부분(125)과 데이터선의 끝부분(179)과 각각 연결되어 있는 접촉 보조 부재(95, 97)가 형성되어 있다. 여기서, 화소 전극(190) 및 접촉 보조 부재(95, 97)는 ITO(indium tin oxide) 또는 IZO(indium zinc oxide)로 이루어져 있다.

- <158> 이제, 색필터 표시판에 대하여 설명한다.
- <159> 유리 등의 투명한 절연 기판(210)의 일면에 빛샘을 방지하기 위한 블랙 매트릭스(220)가 형성되어 있고, 블랙 매트릭스(220)의 위에는 ITO 또는 IZO 등의 투명한 도전 물질로 이루어져 있으며 절개부(271)를 가지는 공통 전극(270)이 형성되어 있다.
- <160> 여기서 블랙 매트릭스(220)는 데이터선(171)의 굽은 부분에 대응하는 선형 부분과 데이터선(171)의 세로로 뻗은 부분 및 박막 트랜지스터 부분에 대응하는 삼각형 부분을 포함한다.
- <161> 공통 전극(270)의 절개부(271) 역시 구부러져 있어서 굽은 화소 영역을 좌우로 양분하는 모양으로 형성되어 있다. 또, 절개부(271)의 양단은 한번 더 구부러져서 한쪽 끝은 게이트선(121)과 나란하고 다른 한쪽 끝은 데이터선(171)의 세로로 뻗은 부분과 나란하다.
- <162> 이상과 같은 구조의 박막 트랜지스터 표시판과 색필터 표시판을 결합하고 그 사이에 액정을 주입하여 액정층(3)을 형성하면 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정 표시 장치의 기본 패널이 이루어진다.
- <163> 액정층(3)에 포함되어 있는 액정 분자는 화소 전극(190)과 공통 전극(270) 사이에 전계가 인가되지 않은 상태에서 그 방향자가 박막 트랜지스터 표시판(110)과 색필터 표시판(210)에 대하여 수직을 이루도록 배향되어 있고, 음의 유전율 이방성을 가진다. 박막 트랜지스터 표시판과 공통 전극 표시판은 공통 전극(270)의 절개부(271)가 화소 전극(190)의 좌우 중앙에 정확하게 중첩되도록 정렬된다. 이렇게 하면, 화소 영역은 절개부(271)에 의하여 복수의 도메인으로 분할된다. 이 때, 화소 영역은 절개부(271)에 의하여 좌우로 양분되나, 화소의 꺾인 부분을 중심으로 하여 상하에서 액정의 배향 방향이 서로 달라서 4개의 도메인으로 분할된다.

- <164> 액정 표시 장치는 이러한 기본 패널 양측에 편광판, 백라이트, 보상판 등의 요소들을 배치하여 이루어진다. 이 때 편광판은 기본 패널 양측에 각각 하나씩 배치되며 그 투과축은 게이트선(121)에 대하여 나란하거나 수직을 이루도록 배치한다.
- <165> 이러한 구조의 액정 표시 장치는 제1 실시예에서의 이점 이외에도 색필터(230R, 230G, 230B)가 박막 트랜지스터 기판에 형성되므로 두 표시판의 정렬마진이 확대되고, 오버코트막(250)을 생략할 수 있는 등의 추가적인 이점을 갖는다.
- <166> 이러한 구조의 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판을 제조하는 방법은 제1 실시예에 따른 박막 트랜지스터 표시판의 제조 방법에서 감광성 유기막을 도포하여 보호막(180)을 형성하고, 접촉구(181b, 182b, 183b)를 형성하는 공정을 제1 보호막을 증착하는 공정, 색소가 첨가된 감광 물질을 도포, 노광 및 현상하는 과정을 3회 반복하여 적, 녹, 청색 색필터(230R, 230G, 230B)를 형성하는 공정, 감광성 유기막을 도포하여 제2 보호막(802)을 형성하고 제2 보호막(802)을 관통하는 접촉구를 형성하는 공정 및 제2 보호막(802)을 관통하는 접촉구를 통하여 노출되는 제1 보호막(801)을 식각하여 제거하는 공정으로 대체한 것이다.
- <167> 도 19는 본 발명의 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배치도이고, 도 20은 도 19의 XX-XX'선에 대한 단면도이고, 도 21는 도 19의 XXI-XXI'선 및 XXI'-XXI''선에 대한 단면도이다.
- <168> 제4 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판은 제3 실시예에 비하여 다음과 같은 특징을 가진다.
- <169> 데이터선(171, 179), 소스 전극(173) 및 드레인 전극(175)을 포함하는 데이터 배선 아래에 이와 실질적으로 동일한 패턴으로 접촉층(161, 163, 165, 169)이 형성되어 있다. 또, 소

스 전극(173)과 드레인 전극(175) 사이의 채널부가 연결되어 있는 것을 제외하고 비정질 규소 층(151, 154, 159)도 데이터 배선과 실질적으로 동일한 패턴을 가진다.

<170> 제4 실시예는 제3 실시예에 비하여 사진 식각 공정을 1회 감소시킨 공정에 의하여 제조된 박막 트랜지스터 표시판을 사용한 것이다. 즉, 제1 실시예와 제2 실시예의 관계와 유사하다.

<171> 따라서 그 제조 방법은 제2 실시예에 따른 박막 트랜지스터 표시판의 제조 방법에서 감광성 유기막을 도포하여 보호막(180)을 형성하고, 접촉구(181b, 182b, 183b)를 형성하는 공정을 제1 보호막을 증착하는 공정, 색소가 첨가된 감광 물질을 도포, 노광 및 현상하는 과정을 3회 반복하여 적, 녹, 청색 색필터(230R, 230G, 230B)를 형성하는 공정, 감광성 유기막을 도포하여 제2 보호막(802)을 형성하고 제2 보호막(802)을 관통하는 접촉구(181b, 182b, 183b)를 형성하는 공정 및 제2 보호막(802)을 관통하는 접촉구(181b, 182b, 183b)를 통하여 노출되는 제1 보호막(801)을 식각하여 제거하는 공정으로 대체한 것이다.

<172> 도 22와 도 23은 본 발명의 제5 실시예에 따른 액정 표시 장치의 단면도이다.

<173> 제5 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배치도는 발명의 특징적인 면에서 제3 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배치도와 별반 차이가 없으므로 생략한다.

<174> 제5 실시예에 따른 액정 표시 장치는 제3 실시예에서 제2 보호막(802)을 생략한 구조이다. 색소 등의 이물질이 거의 방출하지 않는 색필터(230R, 230G, 230B)를 사용하는 경우에 가능한 구조이다.

<175> 제조 방법에 있어서는 제1 실시예에 따른 박막 트랜지스터 표시판의 제조 방법에서 감광성 유기막을 도포하여 보호막(180)을 형성하고 접촉구(181b, 182b, 183b)를 형성하는 공정을

질화규소를 증착하여 보호막(180)을 형성하고 접촉구(181b, 182b, 183b)를 형성하는 공정 및 색소가 첨가된 감광 물질을 도포, 노광 및 현상하는 과정을 3회 반복하여 적, 녹, 청색 색필터(230R, 230G, 230B)를 형성하는 공정으로 대체한 것이다.

<176> 도 24와 도 25는 본 발명의 제6 실시예에 따른 액정 표시 장치의 단면도이다.

<177> 제6 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판은 제5 실시예에 비하여 다음과 같은 특징을 가진다.

<178> 데이터선(171, 179), 소스 전극(173) 및 드레인 전극(175)을 포함하는 데이터 배선 아래 이와 실질적으로 동일한 패턴으로 접촉층(161, 163, 165, 169)이 형성되어 있다. 또, 소스 전극(173)과 드레인 전극(175) 사이의 채널부가 연결되어 있는 것을 제외하고 비정질 규소층(151, 154, 159)도 데이터 배선과 실질적으로 동일한 패턴을 가진다.

<179> 제6 실시예는 제5 실시예에 비하여 사진 식각 공정을 1회 감소시킨 공정에 의하여 제조된 박막 트랜지스터 표시판을 사용한 것이다.

<180> 그 제조 방법은 제2 실시예에 따른 박막 트랜지스터 표시판의 제조 방법에서 감광성 유기막을 도포하여 보호막(180)을 형성하고 접촉구(181b, 182b, 183b)를 형성하는 공정을 질화규소를 증착하여 보호막(180)을 형성하고 접촉구(181b, 182b, 183b)를 형성하는 공정 및 색소가 첨가된 감광 물질을 도포, 노광 및 현상하는 과정을 3회 반복하여 적, 녹, 청색 색필터(230R, 230G, 230B)를 형성하는 공정으로 대체한 것이다.

<181> 도 26과 도 27는 본 발명의 제7 실시예에 따른 액정 표시 장치의 단면도이다.

<182> 제7 실시예에 따른 액정 표시 장치는 제6 실시예에 비하여 접촉구(181b, 182b, 183b) 부분의 프로파일에 특징이 있다. 즉, 제7 실시예에서는 접촉구(181b, 182b, 183b)에서 보호막

(180)과 색필터(230R, 230G, 230G)의 제거된 영역이 일치한다. 또한, 접촉 보조 부재(95, 97)의 아래에도 색필터(230R)가 형성되어 있다.

<183> 이러한 특징은 다음과 같은 제조 방법상의 차이에 기인한다.

<184> 제6 실시예에서는 보호막(180)에 접촉구(181b, 182b, 183b)를 형성하는 공정을 별도의 사진 식각 공정에 의하여 진행하지만, 제7 실시예에서는 색필터(230R, 230G, 230B)를 형성하는 공정에서 색필터(230R, 230G, 230B)를 관통하는 접촉구(181b, 182b, 183b)를 형성하고, 이를 통하여 노출되는 보호막(180)을 색필터(230R, 230G, 230B)를 식각 마스크로 하여 식각함으로써 접촉구(181b, 182b, 183b)를 형성한다.

<185> 도 28과 도 29는 본 발명의 제8 실시예에 따른 액정 표시 장치의 단면도이다.

<186> 제8 실시예에 따른 액정 표시 장치용 박막 트랜지스터 표시판은 제7 실시예에 비하여 다음과 같은 특징을 가진다.

<187> 데이터선(171, 179), 소스 전극(173) 및 드레인 전극(175)을 포함하는 데이터 배선 아래 이와 실질적으로 동일한 패턴으로 접촉층(161, 163, 165, 169)이 형성되어 있다. 또, 소스 전극(173)과 드레인 전극(175) 사이의 채널부가 연결되어 있는 것을 제외하고 비정질 규소층(151, 154, 159)도 데이터 배선과 실질적으로 동일한 패턴을 가진다.

<188> 제8 실시예는 제7 실시예에 비하여 사진 식각 공정을 1회 감소시킨 공정에 의하여 제조된 박막 트랜지스터 표시판을 사용한 것이다.

<189> 한편, 제7 및 제8 실시예에서 접촉 보조 부재(95, 97) 아래에 형성되는 색필터는 적색 이외에 청색, 녹색 중의 어느 하나이거나 또는 이들 삼색 색필터의 조합이 될 수도 있다.

- <190> 이상의 제1 내지 제8 실시예로서 설명한 액정 표시 장치에서 공통 전극 절개부의 모양은 변형될 수 있고, 화소 전극에도 절개부를 형성할 수 있다. 이러한 변형의 예를 제9 및 제10 실시예로서 설명한다.
- <191> 도 30은 본 발명의 제9 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배치도이다.
- <192> 제9 실시예는 제1 실시예에 비하여 공통 전극 절개부(271) 중 게이트선(121)과 나란한 부분이 생략된 것이 특징이다.
- <193> 도 31은 본 발명의 제10 실시예에 따른 액정 표시 장치의 배치도이다.
- <194> 제10 실시예는 제1 실시예에 비하여 공통 전극 절개부(271)의 중앙 굴절부에 가로 방향으로 가지 절개부가 연결되어 있고, 화소 전극(190)에도 절개부(191)가 형성되어 있는 것이 특징이다.
- <195> 이러한 공통 전극(270)의 가지 절개부나 화소 전극(190)의 절개부는 화소 영역이 구부러지는 부분에서의 도메인 분할을 도와준다.
- <196> 그리고 이상 설명한 제1 내지 제 10 실시예에 따른 박막 트랜지스터 표시판에는 돌기(280)와 동일한 층에 컬럼 스페이서(도시하지 않음)를 더 형성할 수 있다. 컬럼 스페이서는 돌기를 형성할 때 노광량 차이를 이용하여 서로 높이가 다른 컬럼 스페이서와 돌기를 동시에 형성할 수 있다. 노광량을 달리하는 방법은 기 설명한 슬릿 패턴 또는 반투명막 등을 이용하여 형성할 수 있다. 이때 감광성 유기막을 이용하여 돌기 및 컬럼 스페이서를 형성하면 감광성 유기막을 노광 및 현상하나, 감광성이 아닌 유기막을 이용할 경우에는 유기막 위에 두께가 다른 감광막을 형성하여 형성할 수 있으나 후자의 공정은 전자의 공정에 비해 훨씬 복잡하다.

<197> 이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리 범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.

【발명의 효과】

<198> 이상과 같이, 본 발명에 따른 유기막 돌기를 데이터선을 덮도록 형성하여 데이터선에 의한 기생 용량을 최소화하고, 액정을 원하는 방향으로 정렬하여 텍스처를 최소화한다. 그리고 액정 분자가 선경사를 가지므로 응답 속도가 향상된다. 또한, 감광성 유기막을 이용하여 동시에 돌기 및 컬럼 스페이서를 형성하여 공정을 간소화할 수 있다.

【특허청구범위】**【청구항 1】**

절연 기판,

상기 절연 기판 위에 형성되어 있는 게이트선 및 게이트 전극을 포함하는 게이트 배선,

상기 게이트선 및 게이트 전극을 덮도록 형성되어 있는 게이트 절연막,

상기 게이트 절연막 위에 형성되어 있는 반도체층,

상기 반도체층의 소정 영역을 제외하고 상기 반도체층 위에 형성되어 있는 저항성 접촉층,

상기 저항성 접촉층과 일부분이 중첩하여 형성되며 상기 게이트선과 교차하여 화소 영역을 정의하는 데이터선, 소스 전극 및 드레인 전극을 포함하는 데이터 배선,

상기 데이터 배선 위에 형성되며 상기 드레인 전극을 노출하는 접촉구를 가지는 보호막,

상기 보호막 위의 상기 데이터 배선과 대응하는 위치에 형성되어 있으며 유기 물질로 이루어져 있는 돌기,

상기 화소 영역과 대응하는 상기 보호막 위에 형성되어 있으며 상기 접촉구를 통해 상기 드레인 전극과 연결되어 있는 화소 전극을 포함하는 박막 트랜지스터 표시판.

【청구항 2】

제1항에서,

상기 게이트선과 동일한 층에 형성되며 상기 게이트선과 평행한 유지 전극선, 상기 유지 전극선의 일부분이 확대 형성되어 상기 드레인 전극과 중첩되어 있는 유지 전극을 더 포함하는 박막 트랜지스터 표시판.

【청구항 3】

제1항에서,

상기 돌기와 동일한 층에 형성되며 상기 돌기보다 높게 형성되어 있는 컬럼 스페이서를 더 포함하는 박막 트랜지스터 표시판.

【청구항 4】

제2항에서,

상기 화소 전극은 절개부를 가지며 상기 유지 전극선은 상기 절개부와 대응하고, 상기 돌기는 절개부에 형성되어 있는 박막 트랜지스터 표시판.

【청구항 5】

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에서,

상기 데이터선은 굽은 부분과 직선 부분을 가지며 상기 직선 부분은 상기 게이트선과 교차하고, 상기 굽은 부분은 상기 화소 영역 내에 위치하는 박막 트랜지스터 표시판.

【청구항 6】

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에서,

상기 데이터선, 드레인 전극 및 소스 전극은 상기 저항성 접촉층과 동일한 평면 패턴으로 형성되어 있고, 상기 저항성 접촉층은 상기 반도체층의 소정 영역을 제외하고 동일한 평면 패턴으로 형성되어 있는 박막 트랜지스터 표시판.

【청구항 7】

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에서,

상기 돌기는 상기 데이터선의 폭보다 넓게 형성되어 있는 박막 트랜지스터 표시판.

【청구항 8】

절연 기판,

상기 절연 기판 위에 형성되어 있는 게이트선 및 게이트 전극을 포함하는 게이트 배선

상기 게이트선 및 게이트 전극을 덮도록 형성되어 있는 게이트 절연막,

상기 게이트 절연막 위에 형성되어 있는 반도체층,

상기 반도체층의 소정 영역을 제외하고 상기 반도체층 위에 형성되어 있는 저항성 접촉층,

상기 저항성 접촉층과 일부분이 중첩하여 형성되며 상기 게이트선과 교차하여 화소 영역을 정의하는 데이터선, 소스 전극 및 드레인 전극을 포함하는 데이터 배선,

상기 데이터선, 소스 전극 및 드레인 전극 위에 형성되어 있는 제1 보호막,

상기 제1 보호막 위에 형성되어 있는 적, 녹, 청색 색필터,

상기 색필터 위에 형성되어 있는 제2 보호막,

상기 제2 보호막 위에 형성되어 있는 돌기,

상기 드레인 전극을 노출하는 접촉구를 통해 상기 드레인 전극과 연결되어 있는 화소 전극을 포함하는 박막 트랜지스터 표시판.

【청구항 9】

제8 항에서,

상기 게이트선과 동일한 층에 형성되며 상기 게이트선과 평행한 유지 전극선, 상기 유지 전극선의 일부분이 확대 형성되어 상기 드레인 전극과 중첩되어 있는 유지 전극을 더 포함하는 박막 트랜지스터 표시판.

【청구항 10】

제8 항에서,

상기 돌기와 동일한 층에 형성되며 상기 돌기보다 높게 형성되어 있는 컬럼 스페이서를 더 포함하는 박막 트랜지스터 표시판.

【청구항 11】

제8 항에서,

상기 화소 전극은 절개부를 가지며 상기 유지 전극선은 상기 절개부와 대응하고, 상기 돌기는 절개부에 형성되어 있는 박막 트랜지스터 표시판.

【청구항 12】

제8항 내지 제11항 중 어느 한 항에서,

상기 데이터선은 굽은 부분과 직선 부분을 가지며 상기 직선 부분은 상기 게이트선과 교차하고, 상기 굽은 부분은 상기 화소 영역 내에 위치하는 박막 트랜지스터 표시판.

【청구항 13】

제8항 내지 제11항 중 어느 한 항에서,

상기 데이터선, 드레인 전극 및 소스 전극은 상기 저항성 접촉층과 동일한 평면 패턴으로 형성되어 있고, 상기 저항성 접촉층은 상기 반도체층의 소정 영역을 제외하고 동일한 평면 패턴으로 형성되어 있는 박막 트랜지스터 표시판.

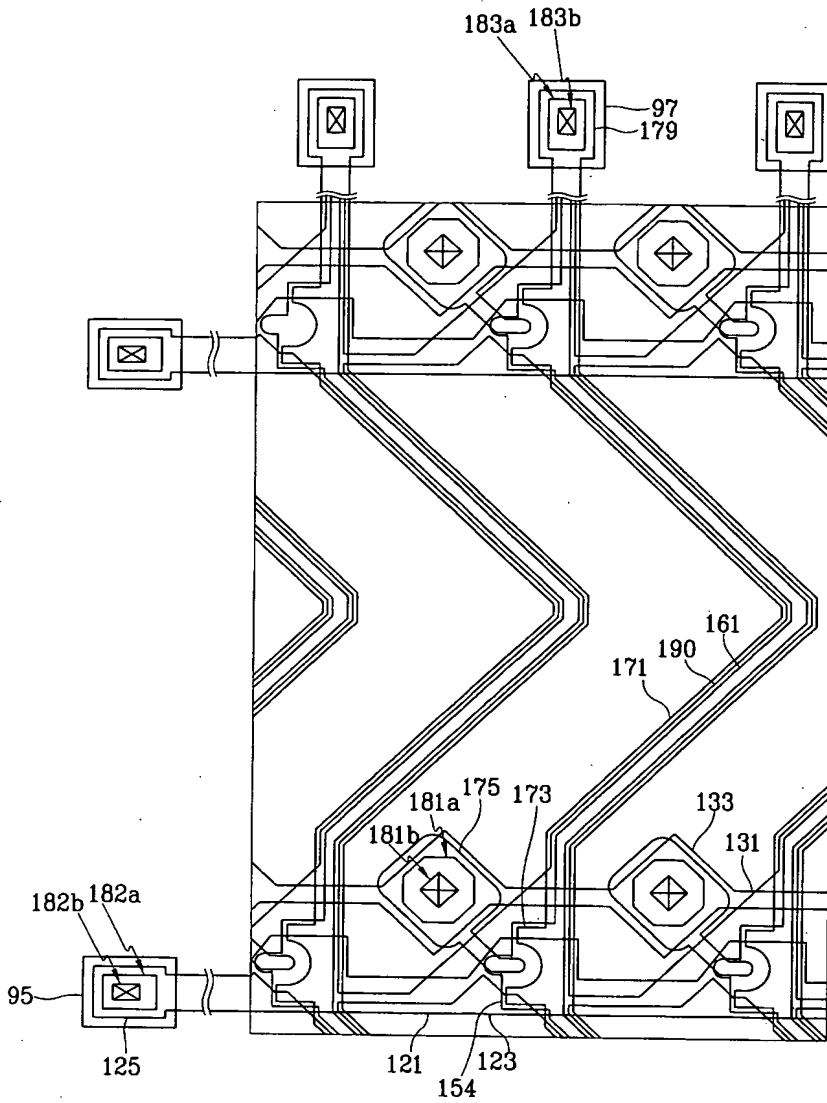
【청구항 14】

제8항 내지 제11항 중 어느 한 항에서,

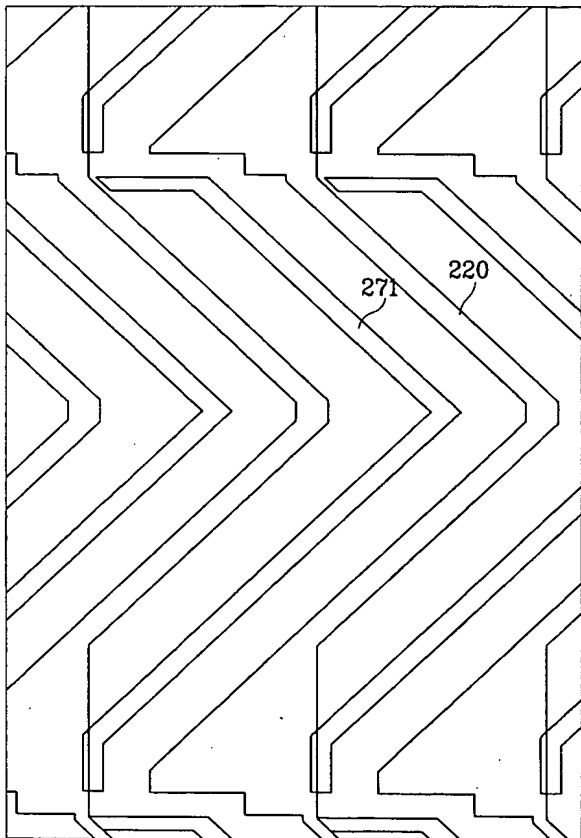
상기 돌기는 상기 데이터선의 폭보다 넓게 형성되어 있는 박막 트랜지스터 표시판.

【도면】

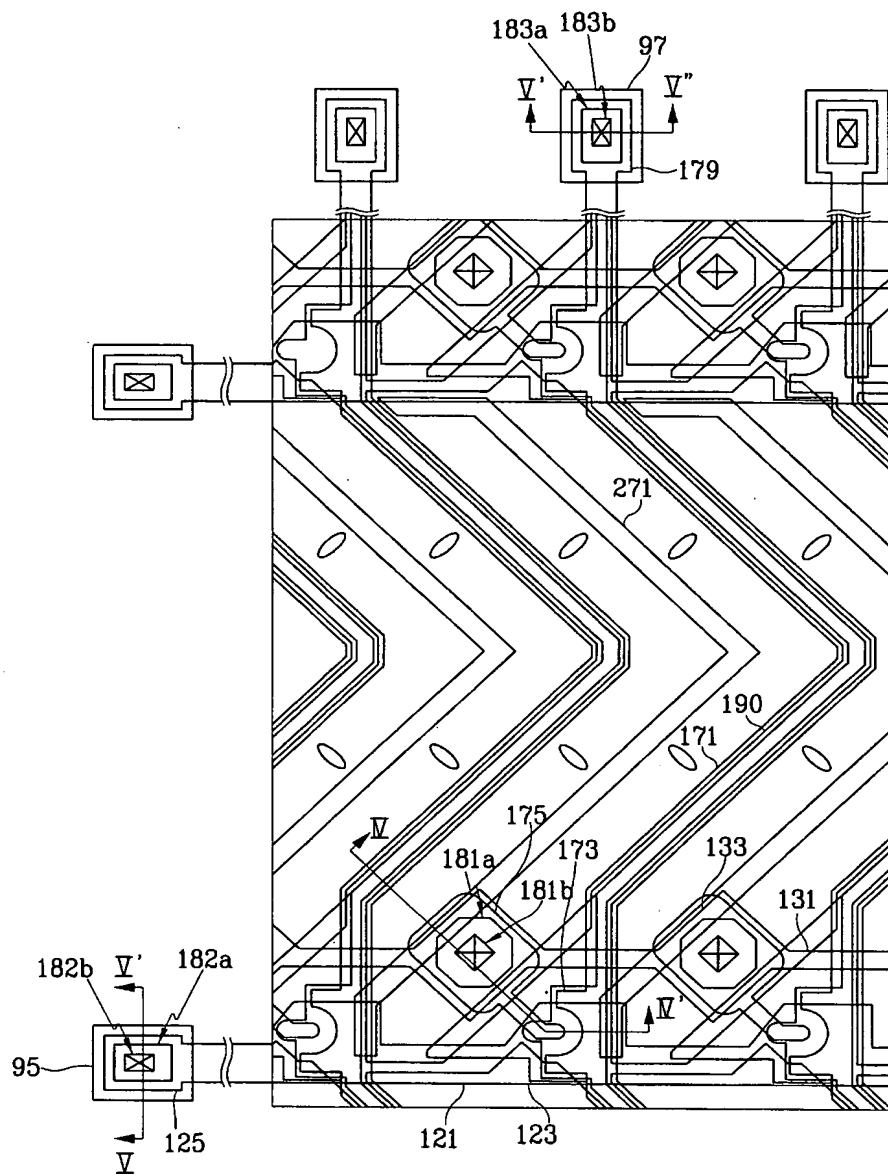
【도 1】



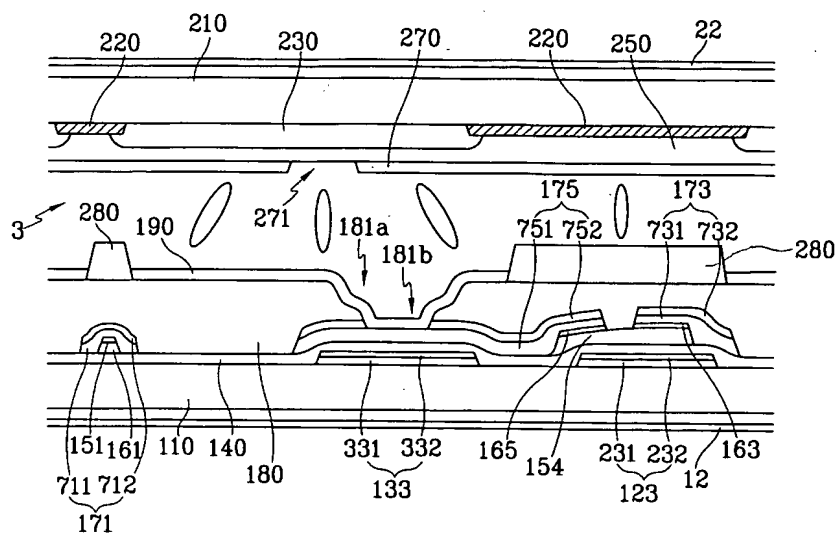
【도 2】



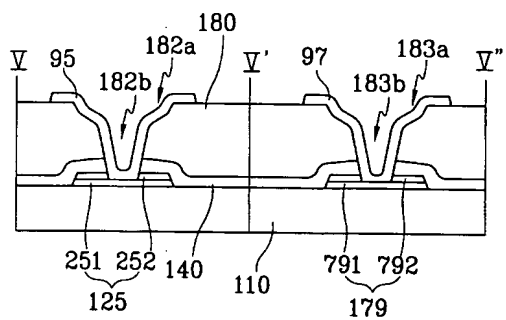
【도 3】



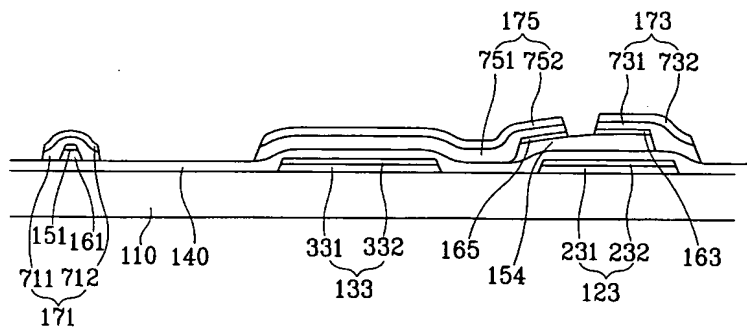
【도 4】



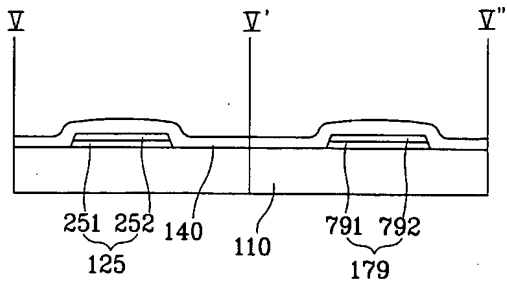
【도 5】



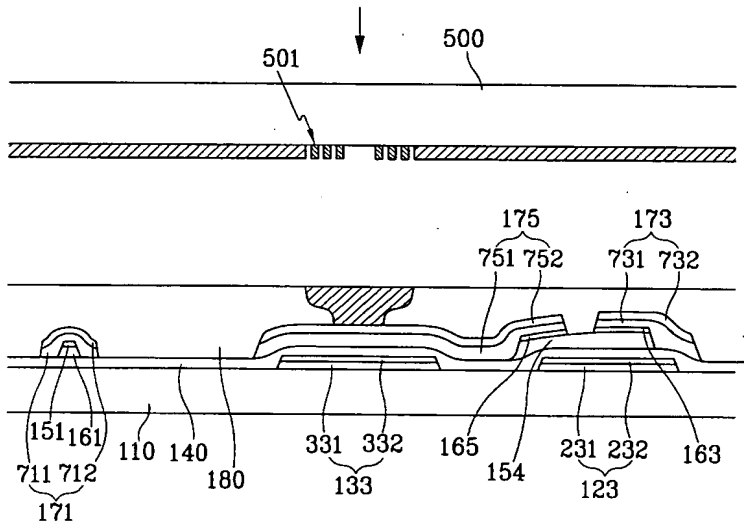
【도 6a】



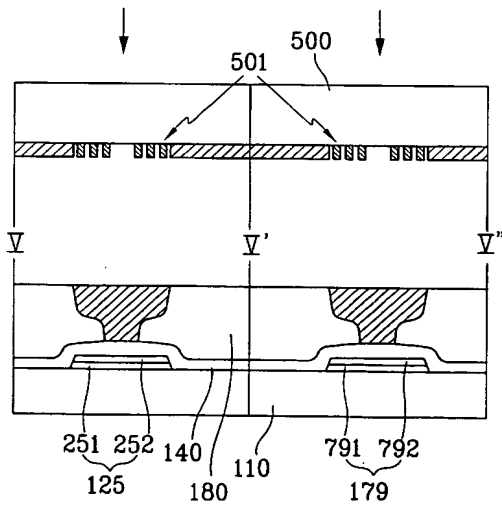
【도 6b】



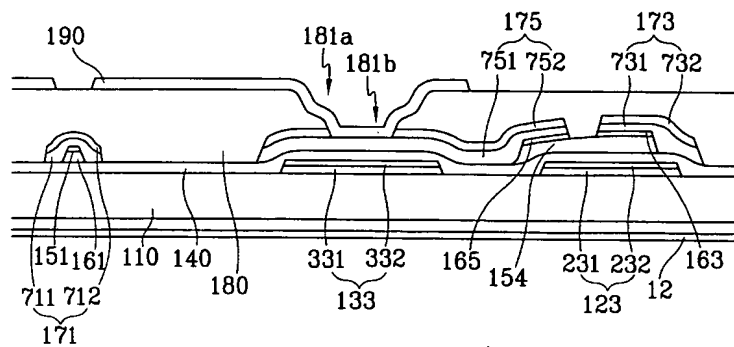
【도 7a】



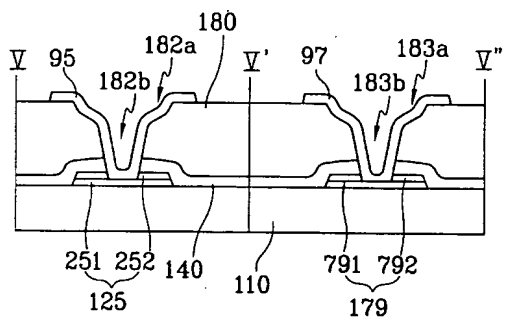
【도 7b】



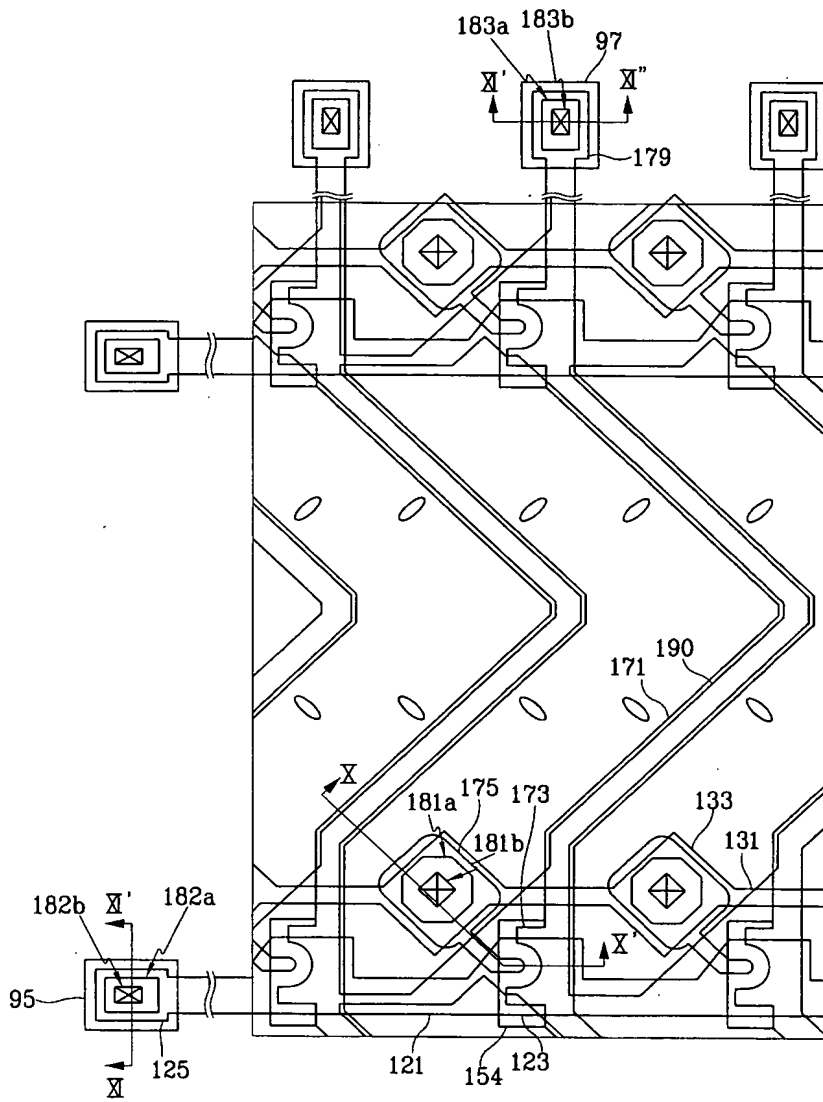
【도 8a】



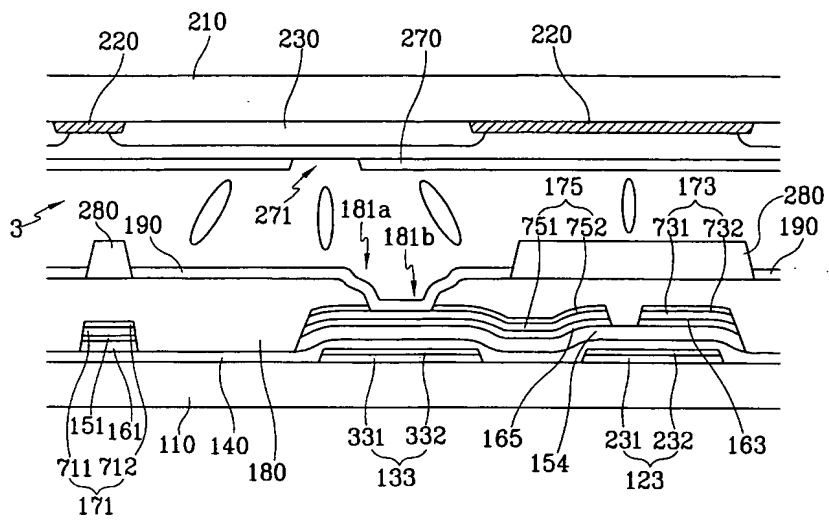
【도 8b】



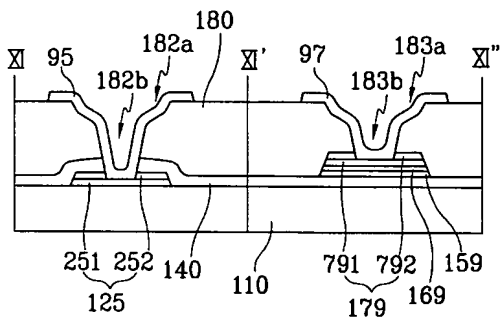
【도 9】



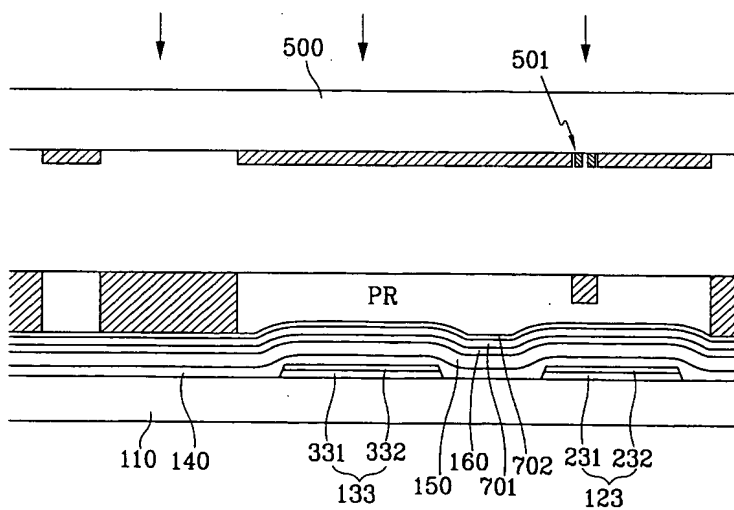
【도 10】



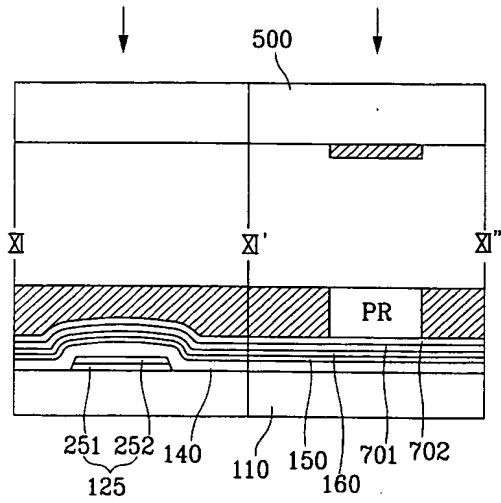
【도 11】



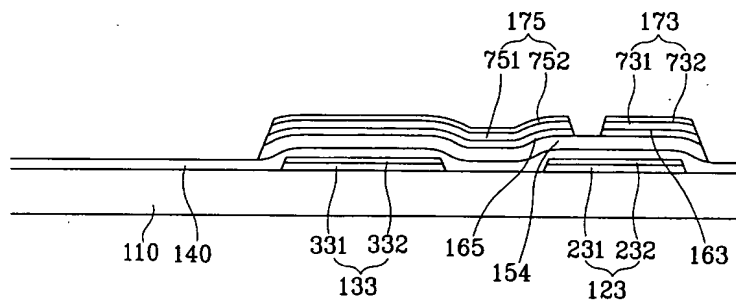
【도 12a】



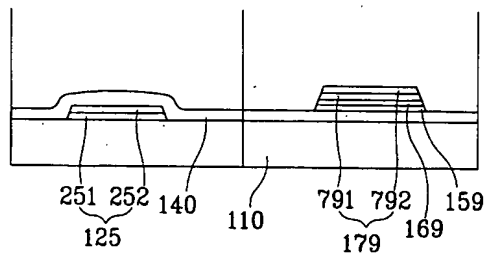
【도 12b】



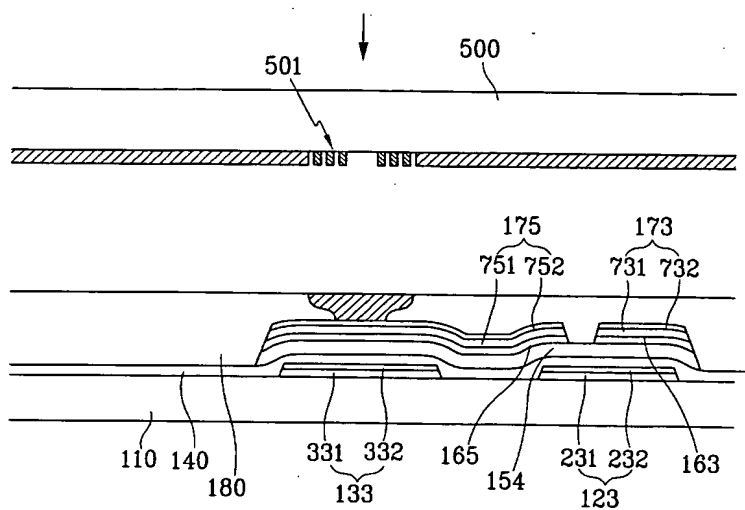
【도 13a】



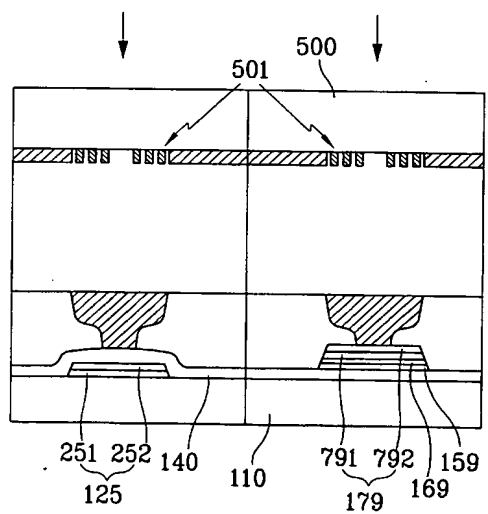
【도 13b】



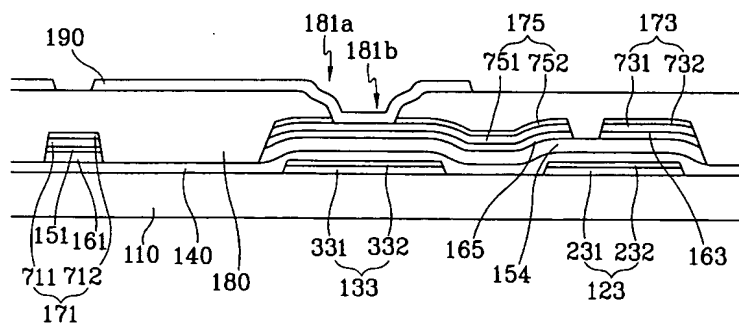
【도 14a】



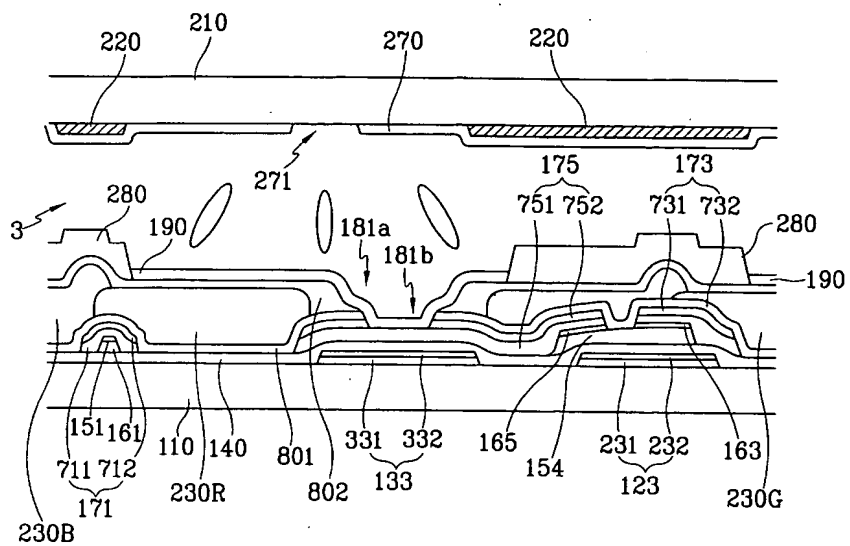
【도 14b】



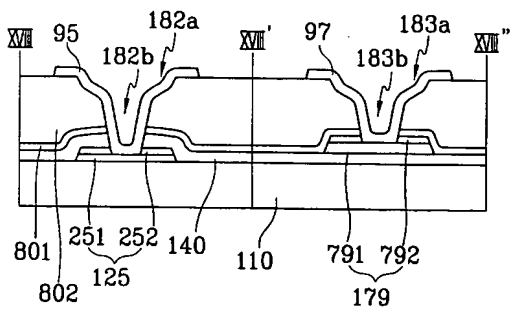
【도 15a】



【도 17】



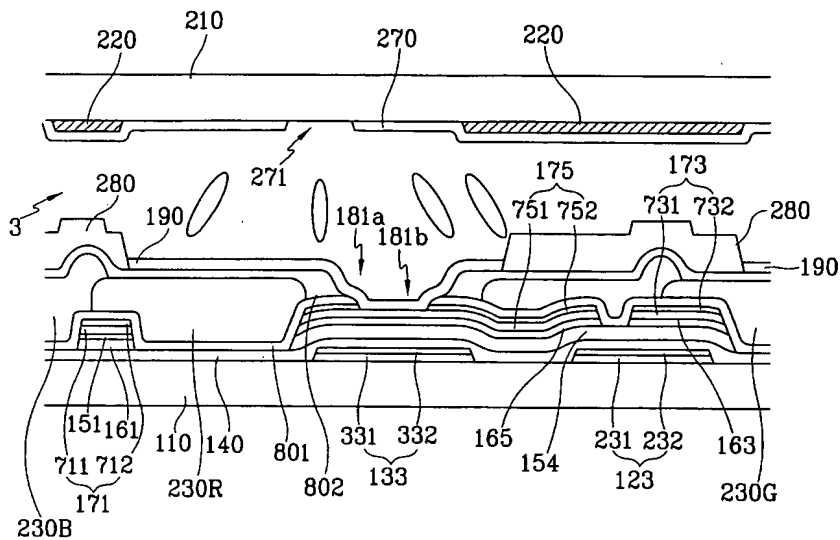
【도 18】



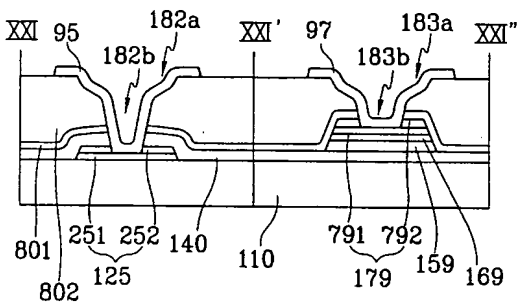
【도 19】



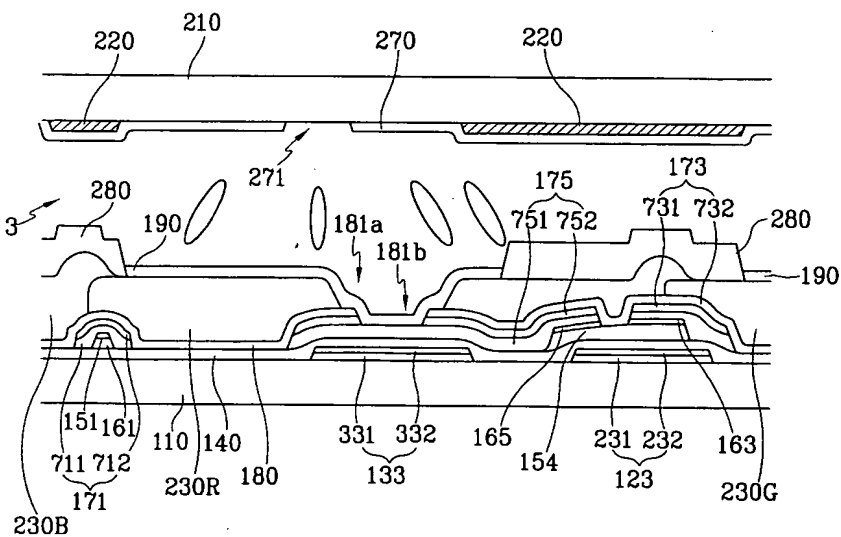
【도 20】



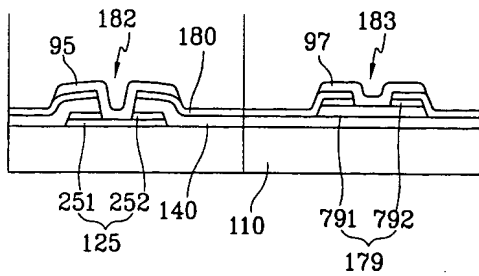
【도 21】



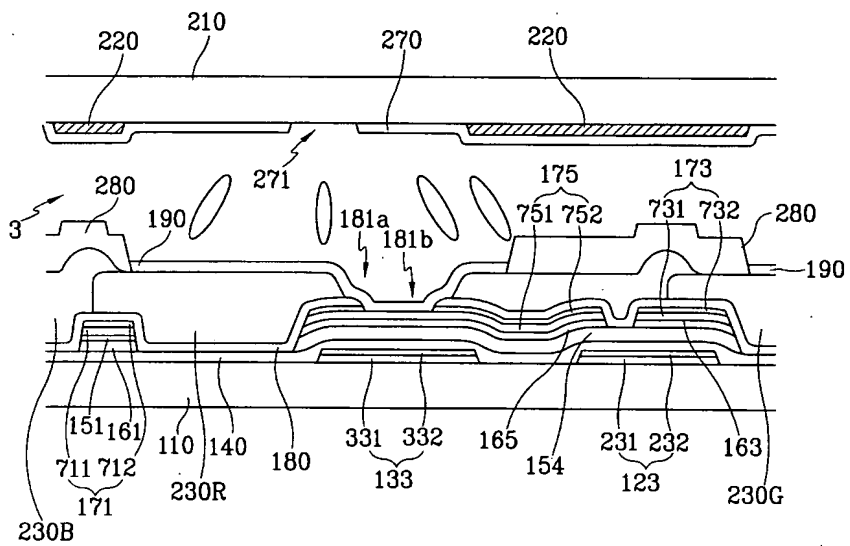
【도 22】



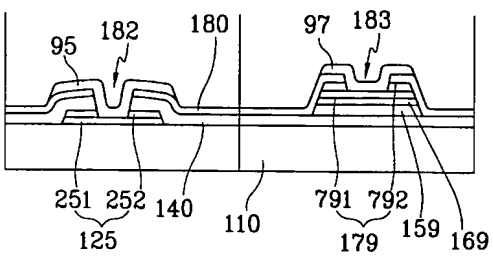
【도 23】



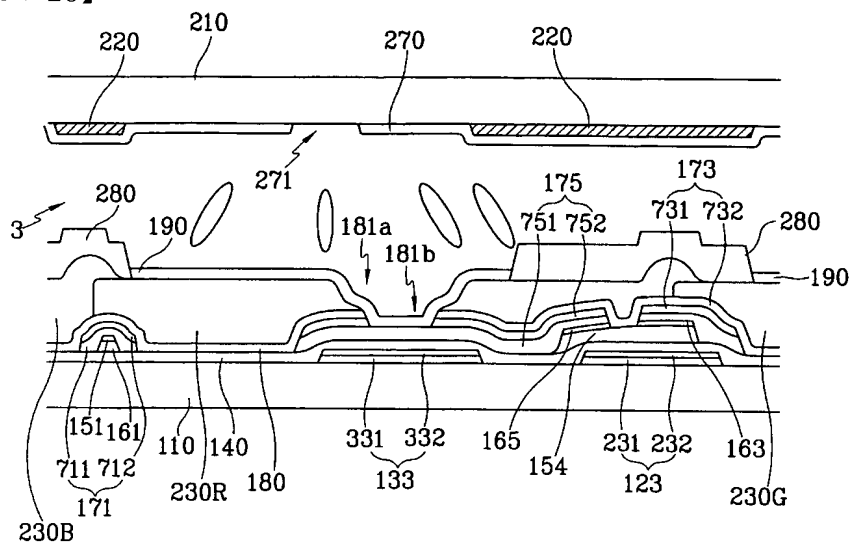
【도 24】



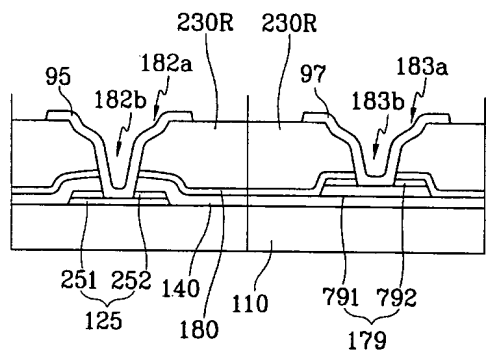
【도 25】



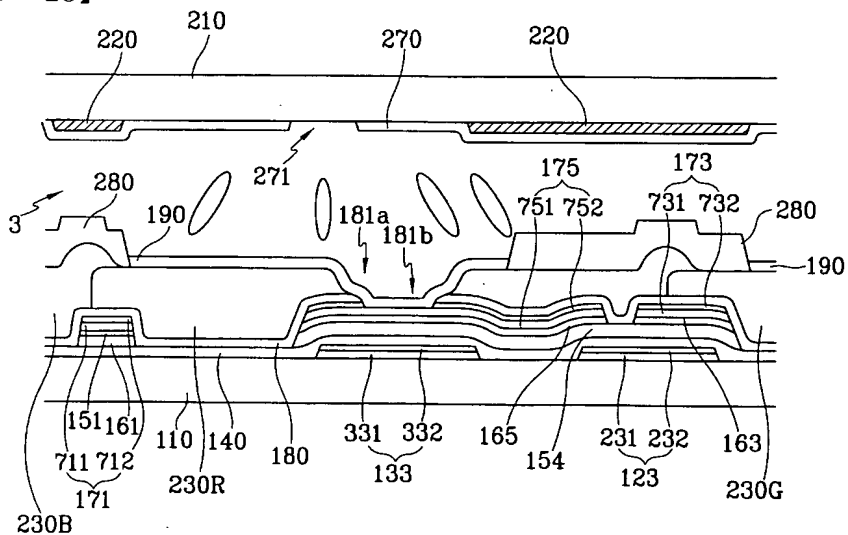
【도 26】



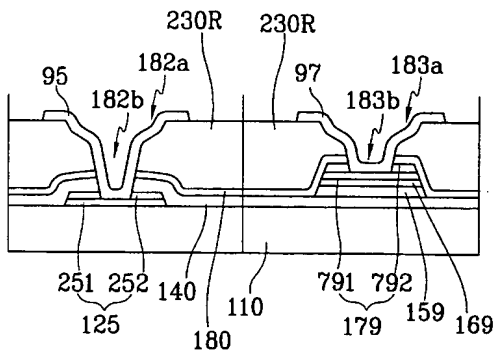
【도 27】



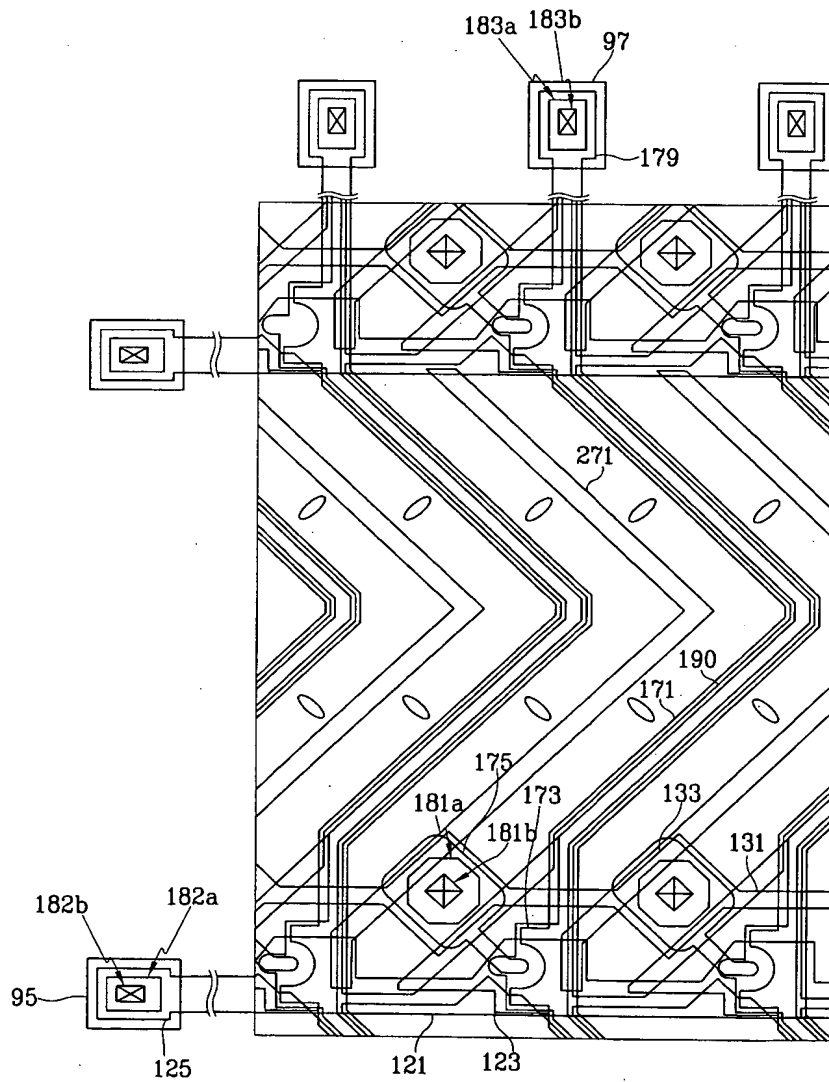
【도 28】



【도 29】



【도 30】



【도 31】

